PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-319698

(43)Date of publication of application: 16.11.2001

(51)Int.Cl.

H01M 14/00

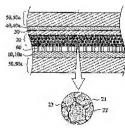
H01L 31/04

(21)Application number : 2000–139042 (71)Applicant : FUJI PHOTO FILM CO LTD
(22)Date of filing : 11.05.2000 (72)Inventor : MIYASAKA TSUTOMU

(54) PHOTOELECTRIC CONVERSION ELEMENT AND PHOTOELECTRIC CELL

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a coloring matter sensitized photoelectric conversion element and a photoelectric cell that have been improved in a converging efficiency, incident photon-to-current conversion efficiency(IPCE) and short-circuit current density (Jsc). SOLUTION: This photoelectric conversion element comprises a optical anode with two or more layers composed of porous semiconductor fine particles, a charge transport layer and a counter electrode. The long wavelength edges of the optical-absorption wavelength range of the optical anode of two layers or more (wavelengths on the long-wavelength side where the absorbance of 10% of the absorbance to the maximum absorption wavelength) are different from each other.



* NOTICES *

JPO and INPIT are not responsible for any

damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely. 2 **** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1]An optical anode more than two-layer [which consists of a porosity semiconductor particulate]. A charge transfer layer.

A counter electrode.

It is the optoelectric transducer provided with the above, and long wavelength ends (wavelength by the side of long wavelength which shows 10% of absorbance of an absorbance in maximal absorption wavelength) of the optical absorption wavelength range of an optical anode more than two-layer [said] differ mutually.

[Claim 2]An optoelectric transducer by which a long wavelength end of an optical absorption wavelength range is arranged more in order of short wavelength in the optoelectric transducer according to claim 1 at the incident light side as for an optical anode more than two-layer [said].

[Claim 3]An optoelectric transducer which laminates 2 or more sets of single cells which consist of an optical anode, a charge transfer layer, and a counter electrode in the optoelectric transducer according to claim 1 or 2.

[Claim 4]An optoelectric transducer whose relative standard deviation of an open circuit light electromotive voltage which said single cell is electrically combined in parallel, and each single cell gives in the optoelectric transducer according to claim 3 is 15% or less.

[Claim 5]An optoelectric transducer whose relative standard deviation of short circuit photoelectric current which said single cell is electrically combined in series, and each single cell gives in the optoelectric transducer according to claim 3 is 15% or less.

[Claim 6]An optoelectric transducer to which sensitization of at least one of said the optical anodes is carried out with coloring matter in the optoelectric transducer according to any one of claims 1 to 5.

[Claim 7]An optoelectric transducer to which sensitization of the optical anode nearest to the light incidence side is carried out with coloring matter in the optoelectric transducer according to any one of claims 1 to 6.

[Claim 8]An optoelectric transducer which is coloring matter in which said coloring matter is chosen from coloring matter of an organometallic complex, a phthalocyanine system, a porphyrin system, and a poly methine system in the optoelectric transducer according to claim 6 or 7.

[Claim 9]An optoelectric transducer which a semiconductor particulate which constitutes said each optical anode turns into from at least one sort of a metallic oxide chosen from titanium oxide, a zinc oxide, a tin oxidation thing, a tungsten oxide, and a niobium oxidation thing in the optoelectric transducer according to any one of claims 1 to 8.

[Claim 10]An optoelectric transducer which at least two of said optical anodes become from a mutually different metallic oxide in the optoelectric transducer according to any one of claims 1 to 9.

[Claim 11]An optoelectric transducer in which said charge transfer layer is an ion-conductive electrolyte in the optoelectric transducer according to any one of claims 1 to 10.

[Claim 12]An optoelectric transducer in which said charge transfer layer is a room temperature fused salt electrolyte in the optoelectric transducer according to any one of claims 1 to 11.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention]This invention relates to the efficient optoelectric transducer by which the semiconductor electrode was laminated, and a photoelectric cell (especially solar cell).

[0002]

[Description of the Prior Art]The foundation established the dye sensitizing of the semiconductor electrode as a means of electrochemical light energy conversion in the 1970s (H. Gerischer, Photochem.Photobiol., 16 volumes, p243-260, 1972). Then, it develops into the sensitization method which uses a coloring matter adsorption thin film for an electrode (T. Miyasaka, et al., Nature, 277 volumes, p638-640, 1979, **, the surface, 19 volumes, p 532 to 541-1981 years), Furthermore particle floc with large adsorption surface area was used for the semiconductor, the extensive improvement of condensing efficiency was achieved, and it improved on the level used as a wet solar cell. It is expected that especially the wet solar cell produced by using the porosity condensation layer of the particles of a dve sensitizing titanium exide semiconductor for an electrode will exceed an amorphous-silicon solar cell in respect of sunlight energy conversion efficiency and low-cost-izing. As the present skill level, a ruthenium complex is used for coloring matter, the visible light up to 800-900 nm can be used, and nearly ten sunlight energy conversion efficiency is acquired. Such essential technology is indicated by Nature, 353 volumes, p 737 to 740-1991 years and, a U.S. Pat. No. 4927721 item, said 5350644 No., JP.5-504023.A, etc. Condensing of incident light, the improvement (or improvement in the short circuit photoelectric current density Jsc) in the quantum efficiency (IPCE) for entering light reflecting the efficiency of quantum conversion of a photon-electron, and improvement in an open circuit light electromotive voltage (Voc) are important in order to improve further the sunlight engineering efficiency of these wet solar cells from now on.

[0003]For this purpose, use for single sensitizing dye Ru complex system black coloring matter which extended the absorption wavelength field to 920 nm in Chem. Commun. and 1705 to p1706-1997 as improvement by the side of a pigment material, and the rate for Mitsutoshi is expanded in a single cell. The art to which Jsc is made to increase is shown. However, this art of the improvement of final efficiency is insufficient as a result of IPCE, Voc. etc. losing in weight on another side which a sensitization wavelength area expands. Although the method of earning efficiency for light utilization combining a dye sensitizing n-type semiconductor is indicated by J.Phys.Chem.B, the 103rd volume, the method of carrying out sensitization of the p-type semiconductor particles to p8940-8943 with coloring matter, and using for an optical cathode, and WO 99/No. 163599 in this optical cathode. In the cell with which the dye sensitizing efficiency and photoelectric current by the side of an optical cathode combined these in series since it was very low compared with them of an optical anode, the optical cathode side serves as a bottleneck of current, and conversion efficiency is not improved.

[0004]On the other hand, although the effect which raises Voc is shown in for example, J. Phys. Chem. B, 103 volumes, and 9238 to p9332-1999, using the high strontium titanate of a conducting-zone energy level

as a near improvement of a semiconductor material, As a result of electron injection's un-increasing the efficiency, IPCE and Jsc decrease, the efficiency of condensing falls and it has not resulted in final improve efficiency.

[0005]Thus, in energy conversion with a dye sensitizing semiconductor, Voc reflecting the energy acquisition reflecting the quantum efficiency of photoelectric conversion of the charge separation of the photoelectric current density Jsc and an electronic-electron hole becomes a relation of a tie in mutually, and these simultaneous improvement is difficult.

[0006]

[Problem(s) to be Solved by the Invention]The purpose of this invention is to provide the optoelectric transducer and photoelectric cell by which the energy conversion efficiency has been improved, and is providing the dye sensitizing type optoelectric transducer and photoelectric cell by which condensing efficiency, the child efficiency (IPCE) for incident light quantity, and short circuit current density (Jsc) have been improved especially.

[0007]

[Means for Solving the Problem]In view of the above-mentioned purpose, as a result of research, wholeheartedly this invention person, In an optoelectric transducer which has an optical anode more than two-layer [which consists of a porosity semiconductor particulate], a charge transfer layer, and a counter electrode, By using two or more optical anodes in which long wavelength ends (wavelength by the side of long wavelength which shows 10% of absorbance of an absorbance in maximal absorption wavelength) of an optical absorption wavelength range differ mutually, It found out that a dye sensitizing type optoelectric transducer by which condensing efficiency, child efficiency (IPCE) for incident light quantity, and short circuit current density (Jsc) have been improved was obtained, and thought out to this invention.

[0008] That is, since an optoelectric transducer of this invention condensed incident light efficiently, it laminated two or more optical anodes in which optical absorption wavelength ranges differ.

[0009]An optoelectric transducer of this invention is used for a photoelectric cell of this invention.

[0010]When this invention fulfills a following condition, an optoelectric transducer which has the further outstanding photoelectric conversion efficiency is obtained.

[0011](1) As for an optical anode more than two-layer [said], it is preferred that a long wavelength end of an optical absorption wavelength range is arranged more in order of short wavelength at the incident light side.

[0012](2) Laminating 2 or more sets of single cells which consist of an optical anode, a charge transfer layer, and a counter electrode has preferred things, it is preferred that relative standard deviation of an open circuit light electromotive voltage which said single cell is electrically combined in parallel, and each single cell gives is 15% or less, or relative standard deviation of short circuit photoelectric current which said single cell is electrically combined in series, and each single cell gives is 15% or less.

[0013](3) It is preferred that at least one of said the optical anodes consists of a porosity semiconductor particulate by which sensitization was carried out with coloring matter, and it is preferred that an optical anode nearest to the light incidence side consists of a porosity semiconductor particulate by which sensitization was carried out with coloring matter. It is preferred that said coloring matter shosen from coloring matter of an organometallic complex, a phthalocyanine system, a porphyrin system,

and a poly methine system.

[0014](4) It is preferred that a semiconductor particulate which constitutes said each optical anode consists of at least one sort of a metallic oxide chosen from titanium oxide, a zinc oxide, a tin oxidation thing, a tungsten oxide, and a niobium oxidation thing. It is preferred that at least two of said optical anodes consist of a mutually different metallic oxide.

[0015](5) It is preferred that said charge transfer layer is an ion-conductive electrolyte or a room temperature fused salt electrolyte.

[0016]

[Embodiment of the Invention] Since the optoelectric transducer of this invention condenses incident light efficiently, two or more optical anodes (photosensitive layer) in which the long wavelength ends of the sensitization wavelength range differ are used. Here, "the long wavelength end of the sensitization wavelength range" means the wavelength by the side of the long wavelength which shows 10% of absorbance of the absorbance in the maximal absorption wavelength of an optical anode. The optical anode in which long wavelength ends differ is producible by choosing the kind and/or sensitizing dye of a semiconductor which are used for a photosensitive layer.

[0017] The optoelectric transducer of this invention laminates a single cell as preferably shown in drawing 1. A single cell is laminated in order of the transparent conductive layer 10a (or conductive layer 10), the under coat 60, the photosensitive layer 20, the charge transfer layer 30, and the transparent counter electrode conductive layer 40a (or counter electrode conductive layer 40). Said photosensitive layer 20 consists of the charge transporting materials 23 which permeated the opening between the semiconductor particulate 21 by which sensitization was carried out with the coloring matter 22, and the semiconductor particulate 21 concerned. One layer or multilayered constitution may be sufficient as a photosensitive layer. The charge transporting material 23 consists of the same ingredient as the material used for the charge transfer layer 30. In order to give intensity to an optoelectric transducer, the transparent substrate 50a (or substrate 50) may be formed in the conductive layer 10 and/or counter electrode conductive layer 40 side. In this invention, the layer which consists the layer which consists of the conductive layer 10 and the substrate 50 which it is arbitrary and is formed of a "conductive substrate", the counter electrode conductive layer 40, and the substrate 50 it is arbitrary and is formed is called a "counter electrode" below. The thing it was made to make this optoelectric transducer work by connecting with an external circuit is a photoelectric cell. [0018] In this invention, in order to make light reach several photosensitive layers of all from which a sensitization wavelength area differs, the photosensitive layer and conductive layer (and the base material used if needed) by the side of light incidence must be optically transparent substantially. The situation of other photosensitive layers, a conductive layer, and a base material being transparent similarly, and the light which penetrated the upper photosensitive layer penetrating a conductive layer, and resulting in a lower layer photosensitive layer must be satisfied. However, the conductive substrate of the photosensitive layer of the bottom of the heap may be opaque when the photosensitive layer does not arrange in the lower layer. Similarly, when the bottom of the heap is a counter electrode, a counter electrode and its base material may be opaque.

[0019] In the single cell shown in <u>drawing 1</u>, coloring matter 22 grade is excited, the electron of the high energy in the excited coloring matter 22 grade is passed to the conducting zone of the semiconductor

particulate 21, and the light which entered into the photosensitive layer 20 containing the semiconductor particulate 21 by which sensitization was carried out with the coloring matter 22 reaches the conductive layer 10 by diffusion further. At this time, the molecule of the coloring matter 22 grade serves as an oxidant. In a photoelectric cell, while the electron in the conductive layer 10 works in an external circuit, it returns to the oxidant of coloring matter 22 grade through the counter electrode conductive layer 40 and the charge transfer layer 30, and the coloring matter 22 is reproduced. The photosensitive layer 20 works as an optical anode. On the boundaries (for example, the boundary of the conductive layer 10 and the photosensitive layer 20, the boundary of the photosensitive layer 20 and the charge transfer layer 30, the boundary of the charge transfer layer 30 and the counter electrode conductive layer 40, etc.) of each layer, the constituents of each class may be carrying out diffusive mixing mutually.

[0020](A) Explain the laminated structure of the element of example this invention of the internal structure of an optoelectric transducer. Two or more optical anodes, charge transfer layers, and counter electrodes which provide a photosensitive layer are laminated, and the element of this invention is constituted. Several optical anodes in which the long wavelength ends of an optical absorption wavelength differ mutually are laminated and constituted still more preferably. That is, the element of this invention is made for the purpose of condensing incident light efficiently by lamination of two or more optical anodes.

[0021] Here, the example of laminated constitution is shown in drawing 6 from drawing 2. The photosensitive layer 20a which differs in a sensitization wavelength area via the transparent conductive layer 10a to both sides of the water-white base material [like glass] 50a whose drawing 2 is, and the photosensitive laver 20b are covered. The water-white base material 50a which the charge transfer layer 30 was placed by the upper layer and lower layer, and supported the transparent conductive layer 40a as a counter electrode in the topmost part. The base material 50 which supported the counter electrode conductive layer 40 of light reflex nature opaque as a counter electrode same with the bottom of the heap is arranged, and these electrode layers are the cells of the structure laminated by taking electrical junction mutually. 10a and 40a of a conductive layer may be the same substance, or may differ from each other. In this cell, after light enters from the transparent counter electrode layer side and penetrates the charge transfer layer 30, it passes the photosensitive layer 20a and the photosensitive layer 20b one by one, and is reflected by the counter electrode 40 of the bottom of the heap. Here, a photosensitive layer is a porous semiconductor layer, as for the photosensitive layer 20b, it is preferred that the sensitization wavelength area is a long wavelength side more to the photosensitive laver 20a, and the light which was not absorbed by the photosensitive layer 20a is absorbed by the lower layer photosensitive layer 20b. As for the charge transfer layer 30, it is preferred that it is a common substance through the whole cell, and, typically, ion-conductive fused salt is used.

[0022]Although drawing 3 is a cell containing the same photosensitive layers 20a and 20b as drawing 2, the order of lamination differs about the photosensitive layer 20a. The top layers are not a counter electrode but the photosensitive layer 20a, and its base material, the charge transfer layer 30 is placed by the lower layer, and the transparent substrate 50a with which the counter electrode 40a of a transparent conductive layer and other one side covered the transparent conductive layer 10a and the photosensitive layer 20b in one side is put on the bottom of it. Under from it is the same as that of drawing 2, and the light which entered is eventually reflected by the reflexibility counter electrode of the bottom of the heap. The

composition of <u>drawing 3</u> is a point of the optical absorption efficiency of the whole photosensitive layer, and is more preferred than the composition of <u>drawing 2</u>. That is, in <u>drawing 2</u>, since incident light may be first absorbed in part by the charge transfer layer, it may be accompanied by the loss of condensing.

[0023]The composition of <u>drawing 4</u> is an example for which the photosensitive layer from which three sorts of sensitization wavelength areas differ is used. An order of lamination is fundamentally the same as <u>drawing 3</u>, and the photosensitive layer 20c is added to the lower layer of the photosensitive layer 20b on both sides of a counter electrode (40a and 50a). Here, as for the sensitization wavelength area of the photosensitive layer 20c, being located in the long wavelength side is more preferred in respect of condensing efficiency than in respect of the sensitization wavelength area of the photosensitive layer 20b. concrete — the photosensitive layer 20a — blue — a green field — the photosensitive layer 20b — green — the photosensitive layer 20c is designed in a red field have photosensitivity in a red — infrared field.

[0024]Drawing 5 is the composition in which the metal lead 11 for reducing the surface resistance of an electrode to the laminated constitution of drawing 4, and raising electrical conduction to it was made to insert. A lead layer usually consists of the narrow shape of a lattice or parallel linear circuit pattern of width. Specifically, 1 mm and thickness are provided for line width as 0.1 to 1 micrometer of wiring from 10 micrometers. The metal lead 11 is formed in order to raise the electrical conduction of the transparent conductive layer 10a or the transparent counter electrode 40a, and it takes the composition electrically combined with the transparent conductive layer 10a or the transparent conductive layer or the transparent conductive layer 10a, and the base material 50a, and/or between the transparent counter electrode conductive layer 40a and the base material 50a. This lead layer may be opaque and is typically made with the metallic material of low electric resistance.

[0025] Drawing 6 is an example of the composition using the photosensitive layer which differs in three sorts of sensitization wavelength areas, and the common counter electrode of one layer. Use the three transparent base materials 50a like glass, and the photosensitive layer 20a is formed in the undersurface of the 1st base material 50a, While forming the photosensitive layer 20b in the upper surface of the 2nd base material 50a, the photosensitive layer 20c is formed in the undersurface, the common counter electrode 40 is formed in the upper surface of the 3rd base material 50a, and it consists of composition filled up with the charge transfer layer 30, respectively among said photosensitive layers 20a and 20b and between the photosensitive layer 20c and the counter electrode 40. The photosensitive layers 20a, 20b, and 20c and the counter electrode 40 have touched via the charge transfer layer 30, respectively by the leak hole 1a for charge transfer which penetrates the photosensitive layer 20b, the 2nd base material 50a, and the photosensitive layer 20c.

[0026]In the basic constitution of <u>drawing 6</u>, various kinds of auxiliary layers can be inserted and used for an improvement of cell performance from <u>drawing 2</u>. Between a photosensitive layer and a transparent conductive layer, an under coat can be provided as a ground of a photosensitive layer. Lamination is also changeable suitably, such as providing the spacer layer for the prevention from an electric short circuit between a photosensitive layer and a counter electrode layer furthermore.

[0027] In the lamination type structure cell of above-mentioned this invention, although all methods are possible for the way of each photosensitive layer and electric connection of a counter electrode according

to the output (an electromotive voltage and current) made into the purpose, a desirable method is a connection method shown below.

- 1) All the counter electrode is combined in an external circuit, and consider it as a common counter electrode, and similarly combine the transparent conductive layer of the ground of each photosensitive layer in an external circuit, and consider it as a common anode. Namely, the laminated-structure type cell which the single cell which consists of combination of a photosensitive layer and a counter electrode is wired in parallel as an equivalent circuit, and is constituted.
- 2) The laminated-structure type cell constituted by each single cell which serves as a counter electrode from the transparent conductive layer of the ground of this and the photosensitive layer which counters connecting in series as an equivalent circuit.

[0028]The equivalent circuit showed to <u>drawing 7</u> and <u>drawing 8</u> by making into an example the laminated-structure type cell which consists these of three single cells. The composition (<u>drawing 7</u>) of 1 which consists of parallel circuits is more preferred among above 1 and the composition of two. The combination circuit which adopted both of wiring forms (as in-series as parallel) of 1 and 2 can also be used for the cell of this invention.

[0029] The output characteristics of the single cell which constitutes a lamination type cell in relation to the above-mentioned wiring form are the purposes of securing the stability of the performance of a lamination type cell, and it is preferred to fulfill one of the following conditions.

** The percentage which the standard deviation of the open circuit electromotive voltage (Voc) which two or more single cells which consist of an optical anode and a counter electrode are electrically combined in parallel in the equivalent circuit of the cell which laminated these single cells, and each single cell gives gives to average value should be less than 15%.

**The percentage which the standard deviation of the short circuit photoelectric current (Isc) which two or more single cells which consist of an optical anode and a counter electrode are electrically combined in series in the equivalent circuit of the cell which laminated these single cells, and each single cell gives gives to average value should be less than 15%.

[0030](B) It is necessary to use a transparent conductive material from the necessity for light transmission except the conductive substrate of the conductive substrate bottom of the heap. A transparent conductive base material is constituted by a transparent conductive layer and two-layer [of the transparent substrate which supports it]. As a conducting agent used for a transparent conductive layer, metal, carbon (for example, platinum, gold, silver, copper, aluminum, rhodium, indium, etc.), or conductive metallic oxide (what doped fluoride to an indium tin multiple oxide and the tin oxide) is mentioned. A thing desirable from an optical transparency point in this is conductive metallic oxide (diacid-ized tin which doped especially fluoride).

[0031]A conductive substrate is so good that surface resistance is low. The range of desirable surface resistance is below 100ohms / **, and is below 40ohms / ** still more preferably. Although there is no restriction in particular in the minimum of surface resistance, they are usually 0.1ohm / ** grade.

[0032]A transparent conductive base material needs a substantially transparent thing, in the wavelength range of 400-900 nm, as for the transmissivity of the whole light, it is preferred that it is not less than 50%, and it is preferred that it is especially not less than 70%.

[0033]As for the coverage of conductive metallic oxide, in order to secure sufficient transparency and to give high conductivity, it is preferred to consider it as per [0.01-100g] base material 1m². As for the thickness of the conductive layer, about 0.02-10 micrometers is preferred.

[0034]What formed the transparent conductive layer which consists of conductive metallic oxide in the surface of transparent substrates, such as glass or a plastic, by spreading or vacuum evaporation as a transparent conductive base material is preferred. The electrically conductive glass which deposited the conductive layer which consists of diacid-ized tin which doped fluoride especially on the transparent substrate made with the sodal lime float glass of low cost is preferred. In order to consider it as a flexible optoelectric transducer or solar cell by low cost, it is good to use for a transparent polymer film what provided the conductive layer. As a material of a transparent polymer film, a tetraacetyl cellulose (TAC), Polyethylene terephthalate (PET), polyethylenenaphthalate (PEN), Syndiotactic poly sterene (SPS), a polyphenylene sulfide (PPS), There are polycarbonate (PC), polyarylate (PAr), polysulfone (PSF), polyester sulfone (PES), polyether imide (PEI), cyclic polyolefin, bromine-ized phenoxy, etc. As for the coverage of conductive metallic oxide, in order to secure sufficient transparency, it is preferred to consider it as per [0.01-100g] base material 1m² of glass or a plastic.

[0035]It is preferred to use a metal lead in order to lower resistance of a transparent conductive base material. The construction material of a metal lead has preferred metal, such as aluminum, copper, silver, gold, platinum, and nickel, and is preferred. [of especially aluminum and silver] As for a metal lead, it is preferred to install in a transparent substrate by vacuum evaporation, sputtering, etc., and to provide on it the tin oxide which doped fluoride, or the transparent conductive layer which consists of ITO films. After providing a transparent conductive layer in a transparent substrate, it is also preferred to install a metal lead on a transparent conductive layer. The fall of the incident light quantity by metal lead installation may be 1 to 5% more preferably less than 10%.

[0036](C) In a photosensitive layer photosensitive layer, a semiconductor acts as what is called a photo conductor, absorbs light, performs charge separation, and produces an electron and an electron hole. In the semiconductor particulate by which dye sensitizing was carried out, generating of optical absorption, the electron by this, and an electron hole takes place mainly in coloring matter, and a semiconductor particulate receives this electron and bears the role to transmit. As for the semiconductor used by this invention, it is preferred that it is an n-type semiconductor which gives anode current by a conductor electron serving as a carrier under optical pumping.

[0037](1) An element semiconductor like silicon and germanium as a semiconductor particulate semiconductor particulate, the chalcogenide (for example, an oxide and a sulfide) of an III-V system compound semiconductor and metal Compounds (for example, strontium titanate, titanic acid calcium, titanium sodium, barium titanate, potassium niobate, etc.) etc. which have a perovskite structure, such as a selenide, can be used.

[0038]As desirable metal being chalcogenide, titanium, tin, zinc, iron, tungsten, A zirconium, hafnium, strontium, indium, cerium, The oxide of yttrium, a lantern, vanadium, niobium, or tantalum, cadmium, zinc, lead, silver, antimony or the sulfide of bismuth, cadmium or a leaden selenide, the telluride of cadmium, etc. are mentioned. As other compound semiconductors, the selenide of phosphides, such as zinc, gallium, indium, and cadmium, gallium arsenide, or copper-indium, the sulfide of copper-indium, etc. are mentioned.

[0039]The desirable example of the semiconductor used for this invention Si, TiO₂, SnO₂, Fe₂O₃, WO₃, ZnO, Nb₂O₅, CdS, ZnS, PbS, Bi₂S₃, CdSe, CdTe, GaP, InP, GaAs, CuInS₂, Are CuInSe₂ etc. and more preferably TiO₂, ZnO, SnO₂, Fe₂O₃, WO₃, It is Nb₂O₅, CdS, PbS, CdSe, InP, GaAs, CuInS₂, or CuInSe₂, is TiO₂ or Nb₂O₅ especially preferably, and is TiO₃ most preferably.

[0040]A single crystal or polycrystal may be sufficient as the semiconductor used for this invention. Although the single crystal from a viewpoint of conversion efficiency is preferred, from viewpoints of a manufacturing cost, raw-material reservation, an energy payback time, etc., polycrystal is preferred and especially the porous membrane that consists of semiconductor particulates is preferred.

[0041]Although the particle diameter of a semiconductor particulate is generally an order of nm-mu m, as for the mean particle diameter of the primary particle for which it asked from the diameter when the project area was converted into the circle, it is preferred that it is 5-200 nm, and its 8-100 nm is more preferred. As for the mean particle diameter of the semiconductor particulate (aggregated particle) in dispersion liquid, 0.01-10 micrometers is preferred.

[0042]Two or more kinds of particles from which particle size distribution differs may be mixed, and it is preferred that the average size of small particles is 5 nm or less in this case. Particle diameter is big, for example, an about 300-nm semiconductor particle may be mixed in order to scatter incident light and to raise an optical capturing rate.

[0043]As a method of producing a semiconductor particulate, Sumio Sakuhana's company of the "science of sol-gel method" AGUNE ** style (1998), A sol-gel method given in "the thin-layer-coating art by a sol-gel method" (1995), etc. of TECHNICAL INFORMATION INSTITUTE, "composition of the monodisperse particle by the new synthetic method gel -**** method and size gestalt control" of Tadao Sugimoto — wait — ****, the 35th volume, No. 9, and the gel -**** method of a 1012-1018 pages (1996) statement are preferred. The method of producing an oxide for the chloride which Degussa developed by elevated-temperature hydrolysis in an acid water matter salt is also preferred.

[0044]When a semiconductor particulate is titanium oxide, each of above-mentioned sol-gel methods, gel

-***** methods, and elevated-temperature hydrolysis methods in the inside of the acid water matter salt of
a chloride is preferred, but the sulfuric acid method and chlorine method of a statement can also be further
used for Manabu Seino's "titanium oxide physical-properties and applied-technology" Gihodo Shuppan
(1997). Furthermore, as a sol-gel method, the method of the journal OBU American ceramic society of
varves, the 80th volume, No. 12, and a 3157–3171 pages (1997) statement, The method of chemistry OBU
MATERIARUZU of burn sides, the 10th volume, No. 9, and a 2419–2425-page statement is also preferred.
[0045](2) In order to apply the formation semiconductor particulate of a semiconductor particle layer on a
conductive substrate, the above-mentioned sol-gel method other than the method of applying the
dispersion liquid or the colloidal solution of a semiconductor particulate on a conductive substrate, etc. can
also be used. When fertilization of an optoelectric transducer, the physical properties of semiconductor
particulate liquid, the flexibility of a conductive substrate, etc. are taken into consideration, the wet film
production method is comparatively advantageous. As the wet film production method, the applying method
and print processes are typical.

[0046]When compounding the method and semiconductor which are distributed while grinding as a method of producing the dispersion liquid of a semiconductor particulate using the method and mill which are mashed with a mortar other than the above-mentioned sol-gel method, the method of depositing as particles and using it as it is in a solvent, etc. are mentioned.

[0047]As carrier fluid, it is usable in water or various kinds of organic solvents (for example, methanol, ethanol, isopropyl alcohol, dichloromethane, acetone, acetonitrile, ethyl acetate, etc.). In the case of distribution, polymer, a surface-active agent, acid, a chelating agent, etc. may be used as a distributed auxiliary agent if needed.

[0048]As a coating method, the air knife method, the braid method, etc. the roller method, a dip method, etc. as a meter ring system as an application system as that where application and a meter ring are made at identical parts, The slide hopper method given in the wire bar method currently indicated by JP,58-4589.B, a U.S. Pat. No. 2681294 item, said 2761419 No., the 2761791 No., etc., the extrusion method, the curtain method, etc. are preferred. Spin method and a spray method are also preferred as a general aviation. As a wet printing method, letterpress, offset, and the three major print processes of photogravure are begun, and an intaglio, a rubber plate, screen-stencil, etc. are preferred. According to liquid viscosity or wet thickness, the desirable film production method is chosen from these.

[0049] The viscosity of the dispersion liquid of a semiconductor particulate is greatly influenced with additive agents, such as a kind of semiconductor particulate, dispersibility and a use solvent kind, a surface-active agent, and a binder. In a viscous liquid (for example, 0.01 - 500Poise), the extrusion method, the cast method, screen printing, etc. are preferred. It is able for the slide hopper method, the wire bar method, or spin method to be preferred, and to make it a uniform film with hypoviscosity liquid (for example, 0.1 or less Poise). If there is a certain amount of coverage, spreading according to the extrusion method also by the case of hypoviscosity liquid is possible. Thus, what is necessary is just to choose the wet film production method suitably according to the viscosity of coating liquid, coverage, a base material, spreading speed, etc. [0050] The layer of a semiconductor particulate can carry out multilayer spreading of the dispersion liquid of a semiconductor particulate with which not only a monolayer but particle diameter is different, or can also carry out multilayer spreading of the coating layer containing the semiconductor particulate (or a different binder, additive agent) from which a kind differs. Also when thickness is insufficient, multilayer spreading is effective at one-time spreading. The extrusion method or the slide hopper method is suitable for multilayer spreading. When carrying out multilayer spreading, a multilayer may be applied simultaneously, and two coats may be given one by one about ten times from several times. When giving two coats further one by one, screen printing can also be used preferably.

[0051]Since the support pigment quantity per unit project area increases so that the thickness (it is the same as the thickness of a photosensitive layer) of a semiconductor particle layer generally becomes thick, the capturing rate of light becomes high, but since the generated diffusion length of electron increases, the loss by electric charge recombination also becomes large. Therefore, the desirable thickness of the semiconductor particle layer of each optical anode is 0.5-30 micrometers. Since layers other than the bottom of the heap of the opposite hand of light incidence need to make light penetrate while performing optical absorption, as for the thickness of a semiconductor particle layer, 1-10 micrometers is preferred, its 2-9 micrometers are more preferred, and its 4-7 micrometers are still more preferred. The bottom of the heap may be thicker than this. In each optical anode, per base material 1m² of a semiconductor particulate, as for coverage, 0.5-30g are preferred, and 3-12g are more preferred.

[0052]Heat-treating is preferred in order to raise improvement in film strength, and adhesion with a base material, while contacting semiconductor particulates electronically after applying a semiconductor particulate on a conductive substrate. The range of desirable cooking temperature is not less than 40 ** less than 700 **, and is not less than 100 ** 600 ** or less more preferably. Cooking time is 10 minutes – about 10 hours. When using the low base material of the melting point or softening temperature like a polymer film, high temperature processing is not preferred in order to cause degradation of a base material. It is preferred that it is low temperature as much as possible also from the viewpoint of cost. Low temperature—ization becomes possible by concomitant use of the small semiconductor particulate of 5 nm or less described previously, heat-treatment under existence of mineral acid, etc.

[0053]It is the purpose of increasing the surface area of conductor particles in the second half of heat-treatment, or raising the purity near the semiconductor particulate and raising the electron injection efficiency from coloring matter to semiconductor particles, and electrochemical plating treatment using chemical plating and titanium trichloride solution using a titanium tetrachloride aqueous solution may be performed, for example.

[0054]As for a semiconductor particulate, what has large surface area is preferred so that much coloring matter can be adsorbed. For this reason, as for the surface area in the state where the layer of the semiconductor particulate was applied on the base material, it is preferred that they are 10 or more times to a project area, and it is preferred that they are further 100 or more times. Although this maximum does not have restriction in particular, they are usually about 1000 times.

[0055](3) As sensitizing dye used for a coloring matter photosensitive layer, organometallic complex coloring matter, methine coloring matter, prophyrin system coloring matter, and phthalocyanine system coloring matter are preferred. Since the wavelength band of photoelectric conversion is made large as much as possible and conversion efficiency is raised, two or more kinds of coloring matter is mixable. The coloring matter to mix and its rate can be chosen so that it may double with the target wavelength band and intensity distribution of a light source.

[0056]As for such coloring matter, it is preferred to have the suitable bond groups (interlocking group) to the surface of a semiconductor particulate. As desirable bond groups, a COOH group, an OH radical, an SO₂H basis, The chelation group which has pi conductivity like a cyano group, a -P(0) (OH) $_2$ group, a -P(0) (OH) $_2$ group or oxime, dioxime, hydroxyquinoline, salicylate, and an alpha–ketoeno rate is mentioned. A COOH group, a -P(0) (OH) $_2$ group, and especially a -OP(0) (OH) $_2$ group are especially preferred. These bases may form the alkaline metal etc. and the salt, and may form inner salt. If an acidic group is contained like [in case a methine chain forms a squarylium ring and a crocodile NIUMU ring] in the case of poly methine coloring matter, it will be good also considering this portion as bond groups.

[0057] Hereafter, the desirable coloring matter used for a photosensitive layer is explained concretely.

[0058](a) As for a metal atom, when metal-complex-coloring-matter coloring matter is metal complex coloring matter, it is preferred that it is ruthenium Ru. As ruthenium complex coloring matter, for example A U.S. Pat. No. 4927721 item, said 4684537 No., The complex pigment of a statement is mentioned to No. world JP.98.B / [said 5084365 No., said 5350644 No., said 5463057 No., said 5525440 No., JP.7-249790,A, Patent Publication Heisei No. 504512 / ten to / and] 50393 etc.

[0059]The ruthenium complex coloring matter furthermore used by this invention is following general

formula (I):(A,) _Ru (B-a) (B-b) (B-c)... (I)

It is preferred for it to be alike and to be expressed more. A, expresses the ligand chosen from the group which consists of Cl, SCN, H₂O, Br, I, CN, NCO, and SeCN among general formula (1), and p is an integer of 0–3. B–a, B–b, and B–c are the following formulas B–1 to B–10 independently, respectively.: [0060] [Formula 1]

[0061](However, if R₁₁ expresses a hydrogen atom or a substituent and considers it as a substituent.) The alkyl group which is not replaced [substitution with a halogen atom and 1–12 carbon atoms, or]. The aryl group which is not replaced [substitution with the aralkyl group which is not replaced / substitution with 7–12 carbon atoms, or / or 6–12 carbon atoms, or]. A carboxylic acid group and a phosphate group (the acid radical of these may form the salt) are mentioned, Straight chain shape or branched state may be sufficient as the alkyl part of an alkyl group and an aralkyl group, and a monocycle or polycyclic (a condensed ring, a ring set) may be sufficient as the aryl portions of an aryl group and an aralkyl group. The

organic ligand chosen from the compound expressed is expressed. B-a, B-b, and B-c may be the same, or may differ from each other.

[0062]Although a desirable example of metal complex coloring matter is shown below, this invention is not limited to these.

[0063]

[Formula 2]

	(A ₁) _p Hu(B-a)(B-b)(B-o)		b)(B-e)	(1)		
	A ₁	Р	В-а	B-b	В-с	R ₁₁
R-1	SCN	2	B-1	B-1		_
R-2	CN	2	B-1	B-1		
R-3	CI	2	B-1	B-1		
R-4	CN	2	B-7	B-7		
R-5	SCN	2	B-7	B-7		
R-6	SCN	2	B-1	B-2		н
R-7	SCN		B-1	B-3	_	_
R-8	CI		B-1	B-4	_	н
R-9		2	B-1	B-6		н
R-10	SCN	3	B-8			
R-11	CN	3	B-8			
R-12	SCN		B-2	B-8		н
R-13	_	0	B-1	B-1	B-1	_

[0064]

[Formula 3]

[0065] [Formula 4]

R-19

[0066](b) The methine coloring matter with preferred coloring matter used for methine coloring matter this invention is poly methine coloring matter, such as cyanine dye, merocyanine dye, and SUKUWARIRIUMU coloring matter. In these, merocyanine dye and squarylium coloring matter are preferred.

[0067]About a synthetic method of these coloring matter. F.M Harmer (F. M.Hamer) work "heterocyclic party ******* - Cyanine Dyes and Related Compounds (Heterocyclic Compounds-Cyanine Dyes.) and Related Compounds", John Willie and Suns (John Wiley & Sons)-New York, London, 1964 annual

publications, Day em Sturmer (D. M.Sturmer) work "heterocyclic Compounds-Special topics in heterocyclic chemistry (Heterocyclic Compounds-Special.) topics in heterocyclic chemistry", Chapter 18, Section 14, the 482nd to 515 pages, John - Willie and Suns (John Wiley & Sons)-New York, London, 1977 annual publications, "ROZZU chemistry OBU carbon party UNZU (Rodd's Chemistry of Carbon Compounds)" 2nd Edvol.IV, part B, 1977 **, Chapter 15, the 369th to 422 pages, ERUSEBIA science public company ink (Elsevier Science Publishing Company Inc.) company **, New York, the British patent No. 1,077,611, Ukrainskii Khimicheskii Zhurnal, the 40th volume, it is indicated in literature etc. which were quoted by No. 3, 253-258 pages. Dves and Pigments, the 21st volume, 227-234 pages, and these articles.

[0068]In addition, phthalocyanine and naphthalocyanine, and the derivative, metal phthalocyanines, Metal naphthalocyanine, the porphyrins containing the derivative, tetraphenylporphyrin, and tetraza porphyrin, the derivative and metalloporphyrin, its derivative, etc. can be used preferably. The coloring matter used for diversities of this invention.

[0069](4) In order to make coloring matter stick to an adsorption semiconductor particulate of coloring matter to a semiconductor particulate, a method of immersing a conductive substrate which has the semiconductor particle layer dry well in a solution of coloring matter, or applying a solution of coloring matter to a semiconductor particle layer can be used. In the case of the former, it is usable in dip coating, a dip method, the roller method, the air knife method, etc. In the case of dip coating, adsorption of coloring matter may be performed at a room temperature, and it may carry out by carrying out heating flowing back as indicated to JP.7-249790.A. As a latter coating method, there are the wire bar method, the slide hopper method, the extrusion method, the curtain method, spin method, a spray method, etc., and printing methods include letterpress, offset, photogravure, screen-stencil, etc. A solvent can be suitably chosen according to the solubility of coloring matter, for example, alcohols (methanol, ethanol, and t-butanol.) nitril (acetonitrile and propionitrile.), such as benzyl alcohol nitromethanes, such as 3-methoxy propionitrile, and halogenated hydrocarbon (dichloromethane.) ether (diethylether.), such as a dichloroethane, chloroform, and chlorobenzene dimethyl sulfoxide, such as a tetrahydrofuran, and amide (N.N-dimethylformamide.) N-methyl pyrrolidone, such as N.N-dimethyl acetamido, 1.3-dimethylimidazolidinone, 3-methyl oxazolidinone, ester species (ethyl acetate, butyl acetate, etc.), Carbonic ester, ketone (diethyl carbonate, ethylene carbonate, propylene carbonate, etc.), hydrocarbon (acetone, 2-butanone, cyclohexanone, etc.) (hexane, petroleum ether, benzene, toluene, etc.), and these mixed solvents are mentioned.

[0070]About viscosity of a solution of coloring matter as well as the time of formation of a semiconductor particle layer, various print processes other than the extrusion method are suitable in a viscous liquid (for example, 0.01 – 500Poise), It is possible to use a film with the slide hopper method, the wire bar method or suitable spin method, and uniform all with hypoviscosity liquid (for example, 0.1 or less Poise).

[0071]Thus, what is necessary is just to choose an adsorption method of coloring matter suitably according to viscosity of coating liquid of coloring matter, coverage, a conductive substrate, spreading speed, etc. When fertilization is considered, as short the one of time which coloring matter adsorption after spreading takes as possible is good.

[0072]Since existence of unadsorbed coloring matter becomes the disturbance of element performance, it is preferred that washing removes promptly after adsorption. It is preferred that use a wet cleaning tank and an organic solvent like polar solvents, such as acetonitrile, and an alcohols solvent washes. In order to

increase the amount of adsorption of coloring matter, heat-treating before adsorption is preferred. After heat-treatment, in order to avoid that water sticks to the semiconductor particulate surface, it is preferred to make coloring matter adsorb quickly among 40–80 **, without returning to ordinary temperature.

[0073] The amount of all [used] of coloring matter has preferred per [unit surface area (1 m²) / 0.01] - 100mmol of a conductive substrate. As for the amount of adsorption to a semiconductor particulate of coloring matter, it is preferred that they are per [semiconductor particulate 1g / 0.01] - 1mmol. By considering it as the amount of adsorption of such coloring matter, the sensitization effect in a semiconductor is fully acquired. On the other hand, if there is too little coloring matter, the sensitization effect will become insufficient, and if there is too much coloring matter, coloring matter which has not adhered to a semiconductor will float and it will become the cause of reducing the sensitization effect.

[0074]Coadsorption of the colorless compound may be carried out to a semiconductor particulate in order to reduce an interaction of the coloring matter like a meeting. A steroid compound (for example, chenodexycholic acid) etc. which have a carboxyl group as a hydrophobic compound which carries out coadsorption are mentioned. An ultraviolet ray absorbent can also be used together.

[0075]After adsorbing coloring matter, amines may be used and the surface of a semiconductor particulate may be processed, in order to promote removal of excessive coloring matter. Pyridine, 4-t-butylpyridine, polyvinyl pyridine, etc. are mentioned as desirable amines. When these are fluids, it may use as it is, and it may dissolve and use for an organic solvent.

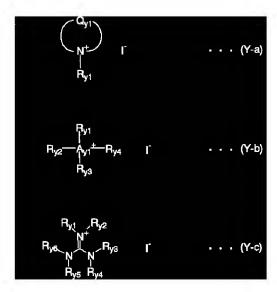
[0076](D) A charge transfer layer charge transfer layer is a layer containing a charge transporting material which has the function to supplement an oxidant of coloring matter with an electron. As an example of a typical charge transporting material which can be used by this invention, ** As an ion transport material, a solution (electrolysis solution) which ion of a redox couple dissolved, what is called a gel electrolyte with which gel of a polymer matrix was impregnated in a solution of a redox couple, a fused salt electrolyte containing a oxidation reduction counter ion, and also a solid electrolyte are mentioned. Carrier movement in ** solid other than a charge transporting material in which ion is concerned can also use an electron transport material and an electron hole (hole) transported material as a material in connection with electrical conduction. These can be used together.

[0077](1) A fused salt electrolyte fused salt electrolyte is preferred from a viewpoint of coexistence of photoelectric conversion efficiency and endurance. When using a fused salt electrolyte for an optoelectric transducer of this invention, For example, known iodine salt, such as pyridinium salt, imidazolium salt, a triazolium salt, etc. which are indicated to WO 95/No. 18456, JP,8-259543,A, electrochemistry, the 65th volume, No. 11, 923 pages (1997), etc., can be used.

[0078]As fused salt which can be used preferably, what is expressed by either a following general formula (Y-a), (Y-b) and (Y-c) is mentioned.

[0079]

[Formula 5]



 $[0080]Q_{\gamma i}$ expresses the atom group who can form the aromatic cation of 5 or 6 membered-rings with a nitrogen atom among a general formula (Y-a). As for $Q_{\gamma i}$, it is preferred to be constituted by one or more sorts of atoms chosen from the group which consists of a carbon atom, a hydrogen atom, a nitrogen atom, an oxygen atom, and a sulfur atom.

[0081]A five-membered ring formed of Q_{vl} An oxazole ring, a thiazole ring, An imidazole ring, a pyrazole ring, an isoxazole ring, a thiadiazole ring, It is preferred that they are an oxadiazole ring or a triazole ring, it is more preferred that they are an oxazole ring, a thiazole ring, or an imidazole ring, and it is preferred that they are especially an oxazole ring or an imidazole ring. As for six membered-rings formed of Q_{vl} , it is preferred that they are a pyridine ring, a pyrimidine ring, a pyridizine ring, a pyrazine ring, or a triazine ring, and it is more preferred that it is a pyridine ring.

 $[0082]A_{y1}$ expresses a nitrogen atom or a phosphorus atom among a general formula (Y-b).

[0083]A general formula (Y-a), (Y-b) and (Y-c) inner $R_{vl} - R_{vl}$ are alkyl groups (even if it is 1-24 carbon atoms and straight chain shape preferably and is branched state) which is not replaced [substitution or] independently, respectively. May be cyclic and For example, a methyl group, an ethyl group, a propyl group, An isopropyl group, a pentyl group, a hexyl group, an octyl group, a 2-ethylhexyl group, t-octyl group, a decyl

group, dodecyl, a tetradecyl group, 2-hexyldecyl group, Alkenyl groups which are not replaced [substitution or], such as an octadecyl group, a cyclohexyl group, and a cyclopentylic group (it may be 2-24 carbon atoms and straight chain shape preferably, or may be branched state, and) For example, a vinyl group with 2-18 carbon atoms, or an alkenyl group with 2-18 carbon atoms, or an alkenyl group with 2-18 carbon atoms more preferably, and is an alkyl group with 2-6 carbon atoms especially preferably.

[0084]Among $R_{\gamma l}$ in a general formula (Y-b) – $R_{\gamma l}$, a non-aromatic ring in which two or more connect with mutually and they contain $A_{\gamma l}$ may be formed, among $R_{\gamma l}$ in a general formula (Y-c) – $R_{\gamma l}$, two or more may connect mutually and they may form a ring structure.

[0085]A general formula (Y-a), (Y-b), inner \mathbf{Q}_{v1} and $\mathbf{R}_{v1} - \mathbf{R}_{v6}$ may have a substituent, and as an example of a desirable substituent, halogen atoms (F, Cl, Br, I, etc.), a cyano group, and an alkoxy group (a methoxy group) aryloxy groups (phenoxy group etc.), such as an ethoxy basis, and an alkylthio group (a methylthio group.) Alkoxycarbonyl groups, such as an ethyl thio group (ethoxycarbonyl group etc.), carbonic ester groups (ethoxycarbonyloxy group etc.) and an acyl group (an acetyl group,) sulfonyl groups (a methane sulfonyl group), such as a propionyl group and benzoyl Acyloxy groups, such as a benzenesulfonyl group (an acetoxy group, a benzoyloxy group, etc.), A sulfonyloxy group (a methane sulfonyloxy group, etc.), phosphonyl groups (diethyl phosphonyl group etc.) and an amide group (an acetylamino group.) Carbamoyl groups (N.N-dimethylcarbamoyl group etc.), such as a benzoylamino group, alkyl group, a methyl group, a propyl group, an isopropyl group, a cyclopropyl group, a butyl group, a 2-carboxyethyl group, betc.), an aryl group (a phenyl group, a toluyl group, etc.), Heterocycle groups (a pyridyl group, an imidazolyl group, a furanyl group, etc.), alkenyl groups (a vinyl group, 1-propenyl group, etc.), etc. are mentioned.

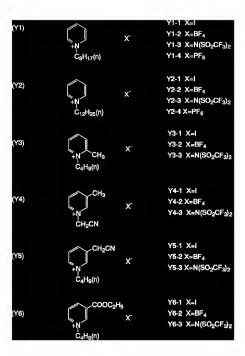
[0086]A compound expressed by a general formula (Y-a), (Y-b), or (Y-c) may form a polymer via Q_{y1} or $R_{y1} - R_{ub}$.

[0087] Such fused salt can also be used together with fused salt which could use it alone, or could use it having mixed two or more sorts and which replaced an iodine anion with other anions. As an iodine anion and an anion to replace, Halide ion, NSC $^-$ (Cl $^-$, Br $^-$, etc.), BF $_4^-$, PF $_6^-$, ClQ $_1^-$ (Cf $_2$ SQ $_2$) N $_2^-$ N $_2^-$ N $_3^{(cF}$ G $_3^{(cF)}$ SQ $_2^-$ C, CF $_3$ SQ $_3^-$ C, CF $_3^-$ CO $_3^-$ C, CF $_3^-$ C, CF

[0088]Although an example of fused salt preferably used by this invention is given to below, it is not necessarily limited to these.

[0089]

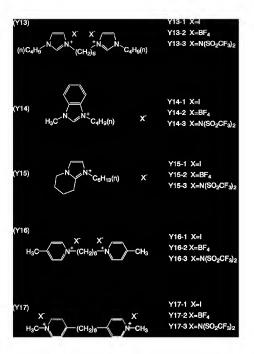
[Formula 6]



[0090] [Formula 7]

				91 Z001 3.
(Y7)	/		Y7-1 X=I	
(17)	H ₃ C N N C₂H ₅	X ⁻	Y7-2 X=BF ₄	
	H_3C C_2H_5	^	Y7-3 X=N(SO ₂ CF ₃) ₂	
			Y7-4 X=Br	
(Y8)			Y8-1 X=I	
(10)	N N [†]	X ⁻	Y8-2 X=BF ₄	
	H ₃ C N C ₄ H ₉ (n)	^	Y8-3 X=N(SO ₂ CF ₃) ₂	
			Y9-1 X=I	
(Y9)	N N+	~	Y9-2 X=BF ₄	
	H ₃ C N C ₆ H ₁₃ (n)	x	Y9-3 X=N(SO ₂ CF ₃) ₂	
	(011 011 0) 011			
	(CH ₂ CH ₂ O) ₂ CH ₃		Y10-1 X=I	
(Y10)		X	Y10-2 X=BF ₄	
	N+	^	Y10-3 X=N(SO ₂ CF ₃);	2
	(CH ₂ CH ₂ O) ₂ CH ₃			
	(CH ₂ CH ₂ O) ₂ CH ₃		Y11-1 X=I	
(Y11)	<u></u> N.		Y11-2 X=BF4	
	CH ₂ OCH ₂ CH ₂ OCH ₃	X	Y11-3 X=N(SO ₂ CF ₃) ₂	
	(CH ₂ CH ₂ O) ₂ CH ₃			
	(CH ₂ CH ₂ O) ₃ CH ₃		Y12-1 X=l	
(Y12)	N		Y12-2 X=BF4	
,		X	Y12-3 X=N(SO ₂ CF ₃)	,
	N+			
	(CH ₂ CH ₂ O) ₃ CH ₃			

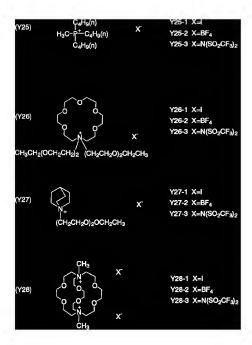
[0091] [Formula 8]



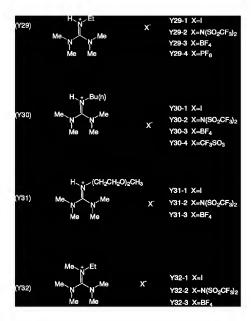
[0092] [Formula 9]

	CH₂CH₃	Y18-1 X=I
(Y18)	CH ₃ CH ₂ -N [±] C ₄ H ₉ (n) X	Y18-2 X=BF₄
	ĆH₂CH₃	Y18-3 X=N(SO ₂ CF ₃) ₂
		Y18-4 X=PF6
		110-4 A=FF6
	ÇH₂CH₃	V40.4 V I
(Y19)	H ₃ C-N [±] -(CH ₂ CH ₂ O) ₂ CH ₃ X	Y19-1 X=I
	CH ₂ CH ₃	Y19-2 X=BF4
	2 0	Y19-3 X=N(SO ₂ CF ₃) ₂
(Y20)	(CH2CH2O)2CH3	Y20-1 X=I
	OCH ₂ CH ₂) ₂ -Ņ [±] -(CH ₂ CH ₂ O) ₂ CH ₃ X	Y20-2 X=BF₄
3(Y20-3 X=N(SO ₂ CF ₃) ₂
	(CH₂CH₂O)₂CH₃	120-0 A=14(00201 3/2
		Y21-1 X=I
(Y21)	(i)C ₃ H ₇	Y21-2 X=BF₄
	(i)C ₃ H ₇ —N*-CH ₂ CH ₃ X	Y21-3 X=N(SO ₂ CF ₃) ₂
	CH₃	121-0 X-N(002013)2
		Y22-1 X=I
(Y22)	ÇH₂CH₃	Y22-2 X=BF₄
	CH₃CH₂──Ņ [±] CH₂CH₂O─ ⟨⟩ X	Y22-3 X=N(SO ₂ CF ₃) ₂
	ĊH₂CH₃	1== = 11 11(==2=1 3/2
		Y23-1 X=I
(Y23)		Y23-2 X=BF4
	×	Y23-3 X=N(SO ₂ CF ₃) ₂
	H ₃ C C₄H ₉ (n)	, , , ,,,
	(%)	Y24-1 X=I
(Y24)	, N x	Y24-2 X=BF ₄
	H ₃ C C ₄ H ₉ (n)	Y24-3 X=N(SO ₂ CF ₃) ₂

[0093] [Formula 10]



[0094] [Formula 11]



[0095] [Formula 12]

[0096]It is more desirable not to use a solvent for the above-mentioned fused salt electrolyte. As for the content of fused salt, although the solvent mentioned later may be added, it is preferred that it is more than 50 mass % to the whole electrolyte composition. It is preferred that more than 50 mass % is iodine salt among salts, and it is still more preferred that it is not less than 70%.

[0097]It is preferred to add iodine to an electrolyte composition, as for content of iodine, it is preferred that it is [as opposed to / the whole electrolyte composition / in this case] 0.1 to 20 mass %, and it is more preferred that it is 0.5 to 5 mass %.

[0098](2) As for an electrolysis solution, when using an electrolysis solution for an electrolysis solution charge transfer layer, it is preferred to comprise an electrolyte, a solvent, and an additive. An electrolyte of

this invention is the combination (as an iodide) of I₂ and an iodide. [LiI and] Metal iodides, such as NaI, KI, CsI, and CaI₂, or tetra alkylammonium iodide, Iodine salt of the 4th class ammonium compounds, such as pyridinium iodide and imidazolium iodide, etc., Combination of Br₂ and a bromide (as a bromide) [LiBr and] Metal bromides, such as NaBr, KBr, CsBr, and CaBr₂. Or others which are the bromine salt of the 4th class ammonium compounds, such as a tetra alkylammonium star's picture and a pyridinium star's picture, etc., Sulfur compounds, such as metal complexes, such as a ferrocyanic acid salt-ferricyanic acid salt and ferrocene ferricinium ion, sodium polysulfide, and alkyl thiol alkyl disulfide, viologen coloring matter, hydroquinone quinone, etc. can be used. An electrolyte which combined iodine salt of the 4th class ammonium compounds, such as I₂, LiI, pyridinium iodide, imidazolium iodide, also in this is preferred in this invention. An electrolyte mentioned above may be mixed and used.

[0099]desirable electrolytic concentration of more than 0.1M is below 15M, and more than 0.2M is below 10M still more preferably. Addition concentration of desirable iodine in a case of adding iodine to an electrolyte is less than more than 0.01M0.5M.

[0100]As for a solvent used for an electrolyte by this invention, it is desirable for a dielectric constant to be high in improving ion mobility low, and for viscosity to be a compound which improves effective-carriers concentration and can reveal outstanding ion conductivity. As such a solvent, carbonate compounds, such as ethylene carbonate and propylene carbonate, Heterocyclic compounds, such as 3-methyl-2-oxazolidinone, dioxane, Ether compounds, such as diethylether, ethylene glycol dialkyl ether, Propylene glycol dialkyl ether, polyethylene-glycol dialkyl ether, Chain ether, such as polypropylene-glycol dialkyl ether, Methanol, ethanol, ethylene glycol monoalkyl ether, Propylene glycol monoalkyl ether, polyethylene-glycol monoalkyl ether, Dolyethylene-glycol monoalkyl ether, Ethylene glycol, propylene glycol, a polyethylene glycol, A polyhydric alcohol class of a polypropylene glycol, glycerin, etc., acetonitrile, Aprotic polar substances, such as nitryl compounds, such as guru taro dinitrile, methoxy acetonitrile, propionitrile, and benzonitrile, dimethyl sulfoxide, and sulfolane, water, etc. can be used.

[0101]At this invention, it is J. Am. Ceram. Soc. and 80. (12) Basic compounds, such as ter-butylpyridine which is indicated to 3157–3171 (1997), 2-picoline, a 2,6-lutidine, can also be added in a desirable density range in a case of adding a basic compound, more than 0.05M is below 2M.

[0102](3) It can also be used in gel electrolyte this invention, making an electrolyte able to gel with techniques, such as polymer addition, oil gelatinizing agent addition, a polymerization containing polyfunctional monomer, and crosslinking reaction of polymer (solidification). When making it gel by polymer addition, it is "Polymer Electrolyte Reviews-1 and 2" (J. R.MacCallum and C.A. Vincent). [jointly and] Although a compound indicated to ELSEVIER APPLIED SCIENCE can be used, especially polyacrylonitrile and polyvinylidene fluoride can be used preferably. By oil gelatinizing agent addition. When making it gel, J. Chem Soc. Japan, Ind. Chem.Sec., 46,779(1943), J. Am. Chem. Soc., 111,5542(1989), J. Chem. Soc., Chem. Com mun. 1993, 390, Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 35-1949 (1996), Although Chem. Lett., 1996, 885, J. Chm. Soc., Chem. Commun., 1997, and a compound indicated to 545 can be used, a desirable compound is a compound which has amide structure in molecular structure.

[0103] When making an electrolyte gel by crosslinking reaction of polymer, it is desirable to use together polymer and a cross linking agent containing a reactant group which can construct a bridge. A reactant group in which desirable bridge construction is possible In this case, nitrogen-containing heterocycle. Are

(for example, a pyridine ring, an imidazole ring, a thiazole ring, an oxazole ring, a triazole ring, a morpholine ring, a piperidine ring, a piperidine ring, a piperazine ring, etc.), and a desirable cross linking agent. They are the reagents (for example, alkyl halide, aralkyl halide, sulfonic ester, an acid anhydride, acid chloride, an isocyanate, etc.) of two or more organic functions in which an electrophilic reaction is possible to a nitrogen atom.

[0104](4) In hole transporting material this invention, a hole transporting material which combined organicity, inorganic matter, or these both instead of an electrolyte can be used.

[0105](a) As an organic hole transporting material applicable to organic hole transporting material this invention, The N.N'-diphenyl N, N'-bis(4-methoxypheny)-(1,1'-biphenyl)-4.4'-diamine (J. Hagenet al., Synthetic Metal 89 (1997) 215-220), A 2,2',7,7'-tetrakis (N,N-di-p-methoxy phenylamine) 9,9'-spirobifluorene (Nature, Vol.395, 8 Oct.1998, p583-585, and WO97/10617), An aromatic diamine compound which connected the 3rd class aromatic amine unit of 1,1-bis[4-(di-p-tolylamino) phenyl] cyclohexane (JP.59-194393.A), 4.4, aromatic amine which two or more fused aromatic rings replaced by a nitrogen atom including two or more tertiary amine represented with **BISU [(N-1-naphthyl) -N-phenylamino] biphenyl (JP,5-234681,A), Aromatictriamine (U.S. Pat. No. 4,923,774, JP,4-308688,A), N.N'-diphenyl N which have starburst structure with a derivative of triphenylbenzene. Aromatic diamine, such as N'-bis(3-methylphenyl)-(1,1'-biphenyl)-4.4'-diamine (U.S. Pat. No. 4,764,625), alpha, alpha, alpha, alpha '- tetramethyl alpha and alpha'-bis(4-di-p-tolylamino phenyl)-p-xylene (JP.3-269084.A). As a p-phenylene diamine derivative and the whole molecule, a triphenylamine derivative unsymmetrical in three dimensions (JP.4-129271.A). A compound which an aromatic diamino group replaced by a pyrenyl group (JP.4-175395.A). Aromatic diamine which connected the 3rd class aromatic amine unit by ethylene (JP,4-264189,A), Aromatic diamine which has styryl structure (JP,4-290851,A), A benzylphenyl compound (JP.4-364153.A), a thing which connected tertiary amine by a fluorene group (JP.5-25473.A). Triamine compound (JP.5-239455.A), pith dipyridyl aminobiphenyl (JP.5-320634.A), N. N. and N-triphenylamine derivative (JP,6-1972,A), Aromatic amine shown in aromatic diamine (JP,7-138562,A) which has FENO affected gin structure, a diaminophenyl phenanthridine derivative (JP,7-252474,A), etc. can be used preferably.

[0106]An alpha-octylthiophene and alpha, and omega-dihexyl- alpha-octylthiophene (Adv. Mater. 1997, 9, N0.7, p557), A hexadodecyl DODESHI thiophene (Angew.Chem. Int. Ed. Engl. 1995, 34, No.3, and p303-307), Oligo thiophene compounds, such as 2,8-dihexyl ANSURA [2,3-b:6,7-b'] dithio Foehn (JACS, Vol120, N0.4-1998, p864-672), Polypyrrole (K. Murakoshi et al.,;Chem. Lett. 1997, p471), "Handbook of Organic ConductiveMolecules and Polymers Vol.1,2,3, 4" (NALWA work.) Polyacethylene indicated to WILEY publication, and its derivative, Poly (p-phenylene) and its derivative, poly (p-phenylenevinylene) and its derivative, poly thienylene vinylene and its derivative, a polythiophene and its derivative, poly aniline, and its derivative, Conductive polymers, such as a polytoluidine and its derivative, can be used preferably.

[0107]In order to control a dopant level to an electron hole (hole) transported material as indicated to Nature, Vol.395, 8 Oct. 1998, and p583–585. In order to add a compound containing a cation radical like tris (4-bromophenyl) aminium hexachloro antimonate or to perform potential control on the surface of an oxide semiconductor (compensation of a space charge layer), a salt like Li [(CF3SO2) 2N] may be added.

[0108](b) A p type inorganic compound semiconductor can be used as an inorganic hole transporting material inorganic matter hole transporting material. As for a p type inorganic compound semiconductor of

this purpose, it is preferred that a band gap is not less than 2 eV, and it is preferred that it is not less than 2.5 more eV. Ionization potential of a p type inorganic compound semiconductor needs to be smaller than ionization potential of conditions to a coloring matter adsorption electrode which can return an electron hole of coloring matter. Although the desirable range of ionization potential of a p type inorganic compound semiconductor changes with coloring matter to be used, generally it is preferred that it is [not less than 4.5 eV] 5.5 eV or less, and it is preferred that it is [not less than 4.7 more eV] 5.3 eV or less. A desirable p type inorganic compound semiconductor is a compound semiconductor containing copper of monovalence, As an example of a compound semiconductor containing copper of monovalence. ** Cul, CuSCN, CulnSe₂, Cu(In, Ga) Se₂, CuGaSe₂, Cu₂O, CuS, CuGaS₂, CuInSe₂, CuAlSe₂, etc. are mentioned. Also in this, Cul and CuSCN are preferred and Cul is the most preferred. As other p type inorganic compound semiconductors, GaP, NiO, CoO, FeO, Bi₂O₃, MoO₂, Cr₂O₃, etc. can be used.

- [0109]As for desirable Hall mobility of a charge transfer layer containing a p type inorganic compound semiconductor, more than 10-4cm²/V-sec is below 10 4cm²/V-sec, More than 10-4cm²/V-sec is below 10 3cm²/V-sec still more preferably. Desirable conductivity of a charge transfer layer of more than 10-8C/cm is below 10 3C/cm, and more than 10-5C/cm is 10 or less S/cm still more preferably.
- [0110](5) Two kinds of methods can be considered about a formation method of a formation charge transfer layer of a charge transfer layer. One pastes a counter electrode together previously on a semiconductor particulate contained layer which made sensitizing dye support, and it is the method of putting a liquefied charge transfer layer between the gap. Another is the method of giving a charge transfer layer directly on a semiconductor particulate contained layer, and a counter electrode will be given after that.
- [0111]A vacuum process which uses a pressure lower than an ordinary pressure process and ordinary pressure which use capillarity by immersion etc. as how to put a charge transfer layer in the case of the former, and replaces the gaseous phase by the liquid phase can be used.
- [0112]in the case of the latter, in a wet charge transfer layer, a counter electrode will be given with un-drying, and a liquid leakage control measure of an edge part will also be taken. There is also a method of applying by a wet type in the case of a gel electrolyte, and solidifying by methods, such as a polymerization, and a counter electrode can also be given after drying and fixing in that case. As a method of giving a wet organicity hole transporting material besides an electrolysis solution, and a gel electrolyte, Dip coating, the roller method, a dip method, the air knife method, the extrusion method, the slide hopper method, the WAYABA method, spin method, a spray method, the cast method, various print processes, etc. can be considered like grant of a semiconductor particulate contained layer or coloring matter.
- [0113] In the case of an electron hole (hole) transported material of a solid electrolyte or a solid, a charge transfer layer can be formed by dry membrane formation processing of a vacuum deposition method, a CVD method, etc., and a counter electrode can also be given after that. An organic hole transporting material can be introduced into an inside of an electrode with techniques, such as a vacuum deposition method, the cast method, the applying method, a spin coat method, dip coating, an electrolytic polymerization method, and photoelectrical depolymerization method. Also in an inorganic solid compound, it can introduce into an inside of an electrode with techniques, such as the cast method, the applying method, a spin coat method, dip coating, and an electrolytic plating method.
- [0114]When considering fertilization, although correspondence is also possible, by closing an edge part

promptly after painting in the case of an electrolysis solution which cannot be solidified, or a wet hole transporting material. In the case of a hole transporting material which can be solidified, after carrying out film formation of the electron hole transporting bed by wet grant, it is more preferred to solidify by methods, such as photopolymerization and a heat radical polymerization. Thus, what is necessary is just to choose a film grant method suitably according to liquid nature or a process condition.

[0115]As moisture in a charge transfer layer, 10,000 ppm or less are 2,000 ppm or less desirable still more preferably, and is 100 ppm or less especially preferably.

[0116](E) The counter electrode counter electrode needs to act as an anode of an optoelectric transducer, and the same transparent conductive material as the above-mentioned conductive substrate needs to be used for it from the necessity for light transmission except a counter electrode of the bottom of the heap. As a conducting material used for a counter electrode conductive layer, metal, carbon (for example, platinum, gold, silver, copper, aluminum, magnesium, rhodium, indium, etc.), or conductive metallic oxide (what doped fluoride to an indium tin multiple oxide and tin oxide) is mentioned. Also in this, platinum, gold, silver, copper, aluminum, and magnesium can be preferably used as a counter electrode layer. An example of a desirable supporting board of a counter electrode is glass or a plastic, is applied or vapor—deposited and uses the above-mentioned conducting agent for this. Although thickness in particular of a counter electrode conductive layer is not restricted, 3 nm - 10 micrometers are preferred. When a counter electrode conductive layer is metal, the thickness is 5 micrometers or less preferably, and ranges of it are 5 nm - 3 micrometers still more preferably. Surface resistance of a counter electrode layer is so good that it is low. As a range of desirable surface resistance, it is below 80ohms / **, and is below 20ohms / ** still more preferably.

[0117]The counter electrode should just stick the conductive layer side of a substrate which applies, plates or vapor—deposits a conducting material directly on a charge transfer layer (PVD, CVD), or has a conductive layer. As well as a case of a conductive substrate when especially a counter electrode is transparent, it is preferred to use a metal lead in order to lower resistance of a counter electrode. A fall of incident light quantity by desirable construction material of a metal lead and an installation method, and metal lead installation is the same as a case of a conductive substrate.

[0118]A counter electrode of the bottom of the heap may be opaque (when there is no photosensitive layer in an opposite hand of a under from a counter electrode, i.e., a light incidence face). From a viewpoint of raising a capturing rate of light, a counter electrode of the bottom of the heap is so preferred that light reflex nature is large. Layer structure of a counter electrode conductive layer which consists of conductive materials may be sufficient as a counter electrode of the bottom of the heap, and it may comprise a counter electrode conductive layer and a supporting board.

[0119](F) When using an electron transport material and a hole transporting material for other layer charge transfer layers, in order to prevent a short circuit of a counter electrode and a conductive substrate, it is preferred to paint a thin film layer of a conductive substrate and a semiconductor precise between photosensitive layers as an under coat beforehand. TiO₂, SnO₂, Fe₂O₃, WO₃, ZnO, and Nb₂O₃ are preferred as an under coat, and it is TiO₂ still more preferably. An under coat can be painted by Electrochimi. Acta 40 and the spray pyrolysis method indicated to 643–652 (1995). Desirable thickness of an under coat is 5–1000 nm or less, and its 10–500 nm is still more preferred.

[0120] Functional layers, such as a protective layer and an antireflection layer, may be provided in both a conductive substrate, and both [one side or] which act as an electrode. When forming such a functional layer in a multilayer, the simultaneous multilayer applying method and the serial applying method can be used, but from a viewpoint of productivity, the simultaneous multilayer applying method is preferred. In the simultaneous multilayer applying method, when productivity and the homogeneity of a coat are considered, the slide hopper method and the extrusion method are suitable. Vacuum deposition, the sticking method, etc. can be used for formation of these functional layers according to the construction material.

[0121]

[Example]Hereafter, an example explains this invention concretely. At this example, the laminate type battery which consists of lamination of <u>drawing 4</u> and an equivalent circuit of <u>drawing 7</u> was assembled in the following procedure.

[0122]1. On one side of the substrate of alkali free glass with a base material thickness for photosensitive layers of 0.4 mm of the production 1 topmost part of a transparent conductive base material. The whole surface was uniformly coated with fluoride dope type diacid—ized tin with the CVD method, and surface resistance about 15ohm/[600 nm in thickness and] **, and light transmittance (500 nm) formed the transparent conductive base material which covered 85% of conductive diacid—ized tin membrane on one side.

2) On one side of the substrate of alkali free glass with a lowermost base material thickness [in pars intermedia] for photosensitive layers of 0.4 mm. The whole surface is uniformly coated with fluoride dope type diacid-ized tin with a CVD method like above 1, On one side, surface resistance about 60hm/[200 nm in thickness and] **, and light transmittance (500 nm) covered 90% of conductive ITO (indium tin oxide) with the CVD method, and both sides have further already formed the base material covered with the transparent conducting film. An ITO film is used as a counter electrode as a ground in which diacid-ized tin membrane supports the photosensitive layer of a dye sensitizing semiconductor in these conducting films. [0123]2. In accordance with the manufacturing method of a statement, in the J.Am.Ceramic Soc.80 volume of preparation C.J.Barbe and others of titanium dioxide particle content coating liquid, and the paper of p3157. Titanium tetra isopropoxide was used for the titanium material, the temperature of the polymerization reaction in the inside of autoclave was set as 230 **, and the titanium dioxide dispersed matter of 11 % of the weight of titanium dioxide concentration was compounded. The average size of the primary particle of the obtained titanium dioxide concentration was compounded. The average size of the primary particle of the obtained titanium dioxide outcless was about 10 mm.

[0124]30% of the weight of the polyethylene glycol (the average molecular weight 20,000, the Wako Pure Chem make) was added and kneaded to the titanium dioxide to this dispersed matter, and the viscous emulsion for spreading was obtained.

[0125]3. This coating liquid is applied to the diacid-ized tin covering surface side of two sorts of transparent conductive substrates produced by 1 and 2 of the production above 1 of a titanium dioxide semiconductor particle layer by a thickness of 100 micrometers with a doctor blade method, After drying for 60 minutes at 25 **, it calcinated for 30 minutes at 500 ** with the electric furnace, and the titanium dioxide layer was covered. The coating volume of the titanium dioxide was 10 g/m², and thickness was 8 micrometers.

[0126]4. As sensitizing dye to 400-600 nm of preparation of a coloring matter adsorption solution which has absorption in the visible wavelength region of short wavelength comparatively. The poly methine coloring

matter (coloring matter A) of the following structural formula was dissolved in the mixed solvent of ethanol:DMSO (95:5) by the concentration of 0.0001 mol / L, 0.04 mol/L addition of the chenodexycholic acid was carried out as an additive agent, and the solution A for adsorption of the sensitizing dye used for the topmost photosensitive layer was prepared.

[0127] [Formula 13]

[0128]As sensitizing dye which has absorption in the long wavelength side to 750 nm, and has an absorption peak in blue – green regions, It dissolved in the mixed solvent of the acetonitrilet-butanol (1:1) which dried Ru complex pigment (coloring matter R-1) of the above-mentioned example at concentration 3x10 -4mol/L, and the adsorption solution B of the sensitizing dye used for the photosensitive layer of pars intermedia was prepared.

[0129]As red sensitizing dye which has absorption to 900 nm in the long wavelength side, Dissolve in the mixed solvent of acetonitrilet-butanol (1:1) at concentration 5x10 -4mol/L, and further Ru complex pigment (coloring matter R-10) of an example as a meeting inhibitor, p-nonylphenoxyethoxy BUCHIRUSURUHON acid sodium was added 0.5% of the weight, it dissolved, and the solution C for adsorption of the sensitizing dve used for the lowermost photosensitive layer was prepared.

[0130]5. Among the substrates with which the adsorption titanium dioxide particulate layer of coloring matter was painted, both sides immersed the conductive substrate in the above-mentioned coloring matter solution A for adsorption to each at the coloring matter solutions B and C for adsorption, and one side neglected the conductive substrate (for topmost part photosensitive layers) at 40 ** under stirring for 3 hours. Thus, after making a titanium dioxide particulate layer dye coloring matter, the electrode was washed by acetonitrile and the dye sensitizing electrode used for the object for the topmost part, the object for pars intermedia, and three sorts of photosensitive layers for the bottoms was produced.

[0131]6. It was failed to scratch the surrounding layer and the euphotic zone of area ² of 1.0 cm was fabricated so that it might become one-side the square of 10 mm about the TiO₂ layer of the dye sensitizing TiO₂ electrode of three sorts of production of a photoelectric cell. These substrates were piled up in order of the topmost part-pars intermedia-bottom so that a photosensitive layer and a counter electrode layer might face each other according to the lamination of <u>drawing 4</u>. Under the lowermost photosensitive layer, the platinum vacuum evaporation glass substrate was arranged as a counter electrode of light reflex nature. Among these substrates, as a frame-shaped spacer, it inserted and the polyethylene film (20 micrometers in thickness) of thermo-compression-bonding nature was piled up so that a photosensitive layer might be surrounded, and two or more substrates which heated the spacer part at 120 ** and were laminated were stuck by pressure, and it fixed. Furthermore, the seal of the edge part of a cell was carried out with epoxy resin adhesive.

[0132]Next, it let the stoma for electrolysis solution pouring in beforehand provided in the corner part of the spacer pass, and the room temperature fused salt which comprises the presentation of Y7-2/Y8-1 / iodine =15.35:1 (weight ratio) as an electrolysis solution was infiltrated into inter-electrode space by a 50 ** basis using capillarity. All of the above cell fabrication process and the process of electrolysis solution pouring were carried out in above-mentioned dew point-60 ** dry air. After pouring of fused salt, the cell was attracted under the vacuum for several hours, the inside of a cell was deaerated, and low melting glass stopped the stoma for pouring in after the end.

[0133] Thus, the dye sensitizing semiconductor wet type photocell (example 1) of this invention in which the photosensitive layer from which a wavelength characteristic differs was laminated was produced.

[0134]The lamination type cell (examples 5 and 6) which changed and laminated an order of lamination of a photosensitive layer that three sorts of sensitization wavelength areas differed, in the similar way was also produced (here, it learned from the above-mentioned method and the substrate of one side conductivity was suitably used for coloring matter adsorption of the topmost photosensitive layer). Only two of three sorts of photosensitive layers were laminated, and the lamination type cell (examples 2-4, and 7) which has arranged the light reflex nature platinum counter electrode to the bottom of the heap was also produced.

[0135]In the long wavelength photosensitive layer, it replaced with the titanium oxide layer which carried out sensitization with the R-10 above-mentioned coloring matter, and the lamination type cell (example 8) using the long wavelength photosensitive layer which made the same coloring matter R-10 stick to a porous diacid-ized tin semiconductor layer was also produced. The photosensitive layer of this diacid-ized tin semiconductor has the character [open circuit voltage / (Voo)] fundamentally in which it is low, compared with the above-mentioned titanium oxide semiconductor photosensitive layer.

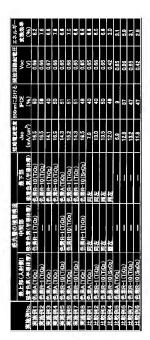
[0136] The lamination type cell (comparative examples 1-4) which laminated the same nature photosensitive layer of a dye sensitizing semiconductor as an object for comparison, and the single cell (comparative examples 5-8) which consists of a single photosensitive layer were prepared for others.

[0137]7. The xenon lamp (USHIO electrical and electric equipment) of the measurement 500W of photoelectric conversion efficiency was equipped with the compensation filter for sunlight simulations (AM1.5direct by Oriel), and the incident light intensity to the cell irradiated with the imitation sunlight adjusted to 100mW[/cm] ².

[0138]The electric generating power of the produced photoelectrochemical cell was inputted into the current potential measuring device (sauce major unit 238 type made from a case rhe), and current/voltage characteristics were measured. Child (%) and the efficiency IPCE for incident light quantity of photoelectric current generating measured in the short circuit current density (Jsc) of the photoelectrochemical cell called for by this and 650 nm of red spectrum regions, the open circuit electromotive voltage (Voc), and the energy conversion efficiency (eta) were indicated to Table 1 with the lamination of the lamination cell.

[0139]

[Table 1]



- [0140] The following things are clear from the result of Table 1.
- 1) The comparative examples 1-4 which laminated the same photosensitive layer of the optical absorption wavelength range, comparing with the single cell (comparative examples 5-8) used as the component the short circuit current density Jsc and an energy conversion efficiency most Jsc and the energy conversion efficiency of Examples 1-8 of the laminated structure according to the conditions of this invention improve to change not being seen.
- [0141]2) From comparison of Example 3 and Example 4, when the upper levels' photosensitive layer is the same, give a high energy conversion efficiency with as high Jsc as that by which the absorption wavelength of the photosensitive layer put on a bottom-of-the-heap part attains to long wavelength more.
- [0142]3) Give a high energy conversion efficiency in the lamination cell using the combination of the same single cell from comparison of Examples 1, 5, and 6 with Jsc with higher the long wavelength end of the

optical absorption wavelength range arranging in the upper levels (incidence side) in order of short wavelength more.

[0143]4) Although Voc is falling in a lamination cell from comparison of Examples 1 and 8 in Example 8 from which Voc of a single cell differs in the range which are 0.42-0.66V compared with Example 1 which has the open circuit electromotive voltage Voc of the single cell which constitutes a cell in 0.65-0.66V, and the almost near range, It is because this has a rate as large as 19% which the standard deviation of Voc of three sorts of single cells gives to average value and change of Voc between single cells is large. However, Example 8 has the merit that Jsc is high, as compared with the comparative examples 1-8.

[0144]Thus, it turns out that the lamination type solar cell made in accordance with the method of this invention is excellent in respect of condensing efficiency, and Jsc and IPCE reflecting it, and gives a high energy conversion efficiency from the result of the above-mentioned example. It turns out that a higher energy conversion efficiency is given in the cell which satisfies the various requirements especially shown in the claim.

[0145]

[Effect of the Invention] As explained in full detail above, the optoelectric transducer of this invention excels [condensing efficiency] in the energy conversion efficiency highly. Therefore, the photoelectric cell which consists of this optoelectric transducer is very effective as a solar cell.

[Brief Description of the Drawings]

[<u>Drawing 1</u>]It is a fragmentary sectional view showing the structure of the desirable optoelectric transducer of this invention.

[Drawing 2] It is a fragmentary sectional view showing the structure of the desirable optoelectric transducer of this invention

[Drawing 3] It is a fragmentary sectional view showing the structure of the desirable optoelectric transducer of this invention.

[Drawing 4] It is a fragmentary sectional view showing the structure of the desirable optoelectric transducer of this invention.

[Drawing 5]It is a fragmentary sectional view showing the structure of the desirable optoelectric transducer of this invention.

[Drawing 6] It is a fragmentary sectional view showing the structure of the desirable optoelectric transducer of this invention.

Drawing 7]It is a sectional view showing the equivalent circuit of the desirable optoelectric transducer of this invention.

[Drawing 8] It is a sectional view showing the equivalent circuit of the desirable optoelectric transducer of this invention.

[Description of Notations]

1 ... Optoelectric transducer

1a ... Leak hole

10 ... Conductive layer

10a ... Transparent conductive layer

11 ... Metal lead

- 20, 20a, 20b, 20c ... Photosensitive layer
- 21 ... Semiconductor particulate
- 22 ... Coloring matter
- 23 ... Charge transporting material
- 30 ... Charge transfer layer
- 40 ... Counter electrode conductive layer
- 40a ... Transparent counter electrode conductive layer
- 50 ... Substrate
- 50a ... Transparent substrate
- 60 ... Under coat
- 2 ... External circuit

[Translation done.]

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-319698 (P2001-319698A)

(43)公開日 平成13年11月16日(2001.11.16)

(51) Int.Cl.7 截別記号 FΙ テーマコード(参考) H 0 1 M 14/00 H 0 1 M 14/00 P 5F051 H01L 31/04 H01L 31/04 Z 5H032

審査請求 未請求 請求項の数13 OL (全 27 頁)

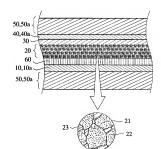
(21)出願番号	特顧2000-139042(P2000-139042)	(71)出職人 000005201
		富士写真フイルム株式会社
(22)出顧日	平成12年5月11日(2000.5.11)	神奈川県南足柄市中沼210番地
		(72)発明者 宮坂 力
		神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真
		フイルム株式会社内
		(74)代理人 100080012
		クライン主人 100000012 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
		1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
		Fターム(参考) 5F051 AA14
		5H032 AA06 AA09 AS16 AS19 CC14
		CC17 EE16 EE17 HH01 HH07

(54) [発明の名称] 光電変換素子および光電池

(57) 【要約】

【課題】 集光効率、対入射光量子効率 (IPCE) 、なら びに短絡電流密度(Jsc)の改善された色素増感型光電 変換素子および光電池を提供する。

【解決手段】 多孔質半導体微粒子からなる2層以上の 光アノードと、電荷輸送層と、対極とを有する光電変換 素子において、前記2層以上の光アノードの光学吸収波 長筆囲の長波長端(最大吸収波長における吸光度の10% の吸光度を示す長波長側の波長)が互いに異なっている ことを特徴とする光雷変換素子。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 多孔質半導体教权子からなると阿以上の だアノードと、電荷移動層と、対極とを有する光電変換 素子において、結記と層以上の光アノードの光学吸収成 長範囲の長波長端(最大吸収波長における吸光度の10% の吸光度を示す長波長側の波長)が互いに異なることを 特徴さする光電変換素子、

【請求項2】 請求項1 に記載の光電変換素子において、前記2 層以上の光アノードは、光学吸収波長範囲の 長波長端がより返波長の順に入射光側に配置されている 10 光電変換素子。

【請求項3】 請求項1又は2に記載の光電変換素子に おいて、光アノード、電荷移動層および対極からなる単 セルを2組以上積層してなる光電変換素子。

【請求項4】 請求項3 に記載の光電変換素子において、前記単セルが電気的に並列に結合され、かつ、各単 セルが与える開放回路光記電圧の相対標準偏差が15%以下である光電変換素子。

【請求項5】 請求項3 に記載の光電変換素子において、前記単セルが電気的に直列に結合され、かつ、各単 20 セルが与える短絡光電流の相対標準偏差が15%以下である光電変換素子。

【請求項6】 請求項1~5のいずれかに記載の光電変 換素子において、前記光アノードの少なくとも1つが、 色素で増感されている光電変換素子。

【請求項7】 請求項1~6のいずれかに記載の光電変 換素子において、光入射側に最も近い光アノードが、色 素で増感されている米電変換素子。

【請求項8】 請求項6又は7に記載の光電変換素子に おいて、前記色素が有機金属錯体、フタロシアニン系、 ポルフィリン系およびポリメチン系の色素から選ばれる 色素である光電変換素子。

【請求項9】 請求項1~8のいずれかに記載の光電変 羨素子において、前記名光アノードを構成する半導体徴 粒子が、チタン酸化物、亜鉛酸化物、スズ酸化物、タン グステン酸化物、ニオブ酸化物から選ばれる金属酸化物 の少なくとも1種からなる光電変換素子。

[請求項10] 請求項1~9のいずれかに記載の光電 変換素子において、前記光アノードのうち少なくとも2 つが、互いに異なる金配線化物からなる光電変換素子。 [請求項11] 請求項1~10のいずれかに記載の光電変換素子において、前記電荷移動層がイオン伝導性電 軽管である光準を換塞子。

【請求項12】 請求項1~11のいずれかに記載の光電変換素子において、前記電荷移動層が室温溶離塩電解質である光雷変換素子。

【請求項13】請求項1~12のいずれかに記載の光電 変換素子を用いた光電池。

【発明の詳細な説明】

[0001]

2 【発明の属する技術分野】本発明は、半導体電極が積層 された高効率の光電変換素子、光電池(特に太陽電池) に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体電極の色素増感は電気化学的光エ ネルギー変換の手段として1970年代に基礎が確立した

(H. Gerischer, Photochem, Photobiol., 14巻, p243-250, 1972年)。その後、色素吸着薄膜を電極に用いる増塞方 法に発展し(T. Miyasaka, et al., Nature, 277巻, p63 8-640, 1979年, 同、表面, 19巻, p532-541, 1981年)、

さらに半導体に吸着表面能の大きい機能子機性体を用いて集光効率の大幅改善が関合れ、混式の太陽電池として 用いるレベルに向上した。とくに、色素消煙運能(チタン) 半導体の機能子の多孔質旋場限を電極に用いて得られる 選式太陽電池は、太陽光エネルギー変換効率と低コスト 化の点でアモルファスシリコン太陽電池を液膜すること が解抄される。現在の技術レベルとして、色素にルテニ ウム雑体を用いて800~900 nまでの可對光を利用で き、105近い太陽光エネルギー変換効率が得られてい 20 る。これらの基幹技術は、Nature、353巻、p737 74 0、1991年ましび料理解表4927719、脂530644号、検 開平5-504023等によって開示されている。これちの複

開平5-50423等によって開示されている。これらの選 式太陽電池の太陽エネルギー変換め率を今後さらに改善 する目的で重要なのが、入射光の集光と光子・電子の順 子変換の効率を反映する対入光脈子効率(IPCE)の向上 (おるいは短絡光電電密度)seの向上)と開回路光起電 圧(Voc)の向上である。

【0003】 この目的のために、色素材料側の改良として、Chem. Commun. p1705-1706,1997年には吸収波長額 城を200 m 助まで広げた船舶体系プラック色素を単一の 増盤低素に用いて単一セルで光手用率を拡大し、Jace 増加させる技術が示されている。しかし、この技術では、感光波長額酸が拡大する他力で1PCEやVocなどが目減りする結果、最終的な効率の改善は不十分である。また、J. Phys. Chem. B. 第103巻, p8940-8943には p型半導体機能子を色素で増張して光カンードを色素増密 n型半導体とを組合せて光利用か幸かせぐ方法が開示されているが、光カソード側の色素増変がまと光電流が光フノードのそれらに比べて極めて低いため、これらを直列に結合したセルでは光カソード側が電流のボトルネックとなり、変換効率が設善されている。

【0004】一方、半導体材料の側の監告としてたとえ ば、J. Phys. Chen. B, 103巻, p9238-9332, 1999年に は、伝導権エネルギー準位の高いチタン酸ストロンチウ ムを用い、Vocを高める効果が示されているが、電子は 入が不効率化した結果、IPEC Lsたが減少して集光の効 率が低下し、最終的な効率向上に至っていない。

【0005】このように色素増感半導体によるエネルギ 50 一変換においては、光電変換の量子効率を反映する光電 流密度Jscと電子-正孔の電荷分離のエネルギー獲得を 反映するVocが互いに取り合いの関係になり、これらの 同時改良が難しい。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】 本発明の目的は、エネ ルギー変換効率の改善された光電変換素子および光電池 を提供することであり、とくに、集光効率、対入射光量 子効率 (IPC) 、ならびに短絡電流密度 (Isc) の改善 された色素単速型光電変換素子および光電池を提供する ことである。

[0007]

【認題を解決するための手段】上記目的に鑑か規定制作の 的結果、本発明者は、多孔質半導体微粒子からなる 2 層 以上の光アノードと、電荷等動簡と、対極とを有する光 電変換素子において、光学吸皮波長範囲の長級長端 長吸皮波長における吸光度の10%の吸光度を示す長波長 側の波長)が延いに異なる2以上の光アノードを用いる ことにより、集光効率、対入射光量子効率(IPCE)、な らびに短線電流密度(Jos.)の改善された色素物感型光 電変換素子が得られることを見出し、本発明に壓到し

「0008] すなわち、本発明の光電変換素子は、入射 光を効率良く集光するため、光学吸収波長範囲の異なる

2以上の光アノードを積層したことを特徴とする。 【0009】また、本発明の光電池は、本発明の光電変 換素子を用いたものである。

【0010】本発明は下記条件を満たすことにより、一層優れた光電変換効率を有する光電変換素子が得られ

【0011】(1)前記2層以上の光アノードは、光学 30 吸収波長範囲の長波長端がより短波長の順に入射光側に 配置されていることが好ましい。

【0012】(2) 光アノード、電荷移動樹さよび対極 からなる単セルを2組以上積層してなることが好まし 、前記単生ルが電気的に並列に結合され、かつ、各単 セルが与える開放回路光起電圧の相対標準偏差が15%以 下であるか、又は、前記単セルが電気的に直列に結合さ れ、かつ、各単セルが与える短絡光電流の相対標準偏差 が15%以下であることが存ましい。

【0013】(3)前窓光アノードの少なくとも1つ が、色素で増感された多孔質半導体微粒子からなること が好ましく、光入射側に最上近い光アノードが、色素で 増感された多孔質半導体微粒子からなることが好まし い。また、前記色素が有機る原錦体、フタロシアニン 系、ボルフィリン系およびポリメチン系の色素から選ば れる色素であることが好ましい。

【0014】(4) 前記各光アノードを構成する半導体 微粒子が、チタン酸化物、亜鉛酸化物、スズ酸化物、タ ングステン酸化物、ニオブ酸化物から選ばれる金属酸化 物の少なくとも1種からなることが好ましい。また、前 50

記光アノードのうち少なくとも2つが、互いに異なる金 属酸化物からなることが好ましい。

【0015】(5)前記電荷移動層が、イオン伝導性電解質又は室温溶融塩電解質であることが好ましい。 【0016】

【毎期の実施の形態】本発明の光電変換素子は、入射光 を効率良く集光するため、感光波長範囲の長波良端の異 なる光アノード (壊光隙)を複旋削いることを特徴とす る。ここで、「爆光波長範囲の長波長端」とは、光アノ 中の最大吸波をはては7を吸光(空の10%の数)を使るデ す長波長側の波長をいう。長波長端の異なる光アノード は、感光層に使用する半導体の種類および/または増盛 の基金複和することにより作型できる。

【0017】本発明の光電変換素子は、好ましくは図1 に示すような単セルを積層したものである。単セルは、 透明導電層10a(又は導電層10)、下塗り層60、感光層2 電荷移動層30、透明対極導電層40a(又は対極導電層 40) の順に積層し、前記感光層20を色素22によって増感 された半導体微粒子21と当該半導体微粒子21の間の空隙 に浸透した電荷輸送材料23とから構成する。感光層は、 1層でも多層構成でもよい。電荷輸送材料23は、電荷移 動層30に用いる材料と同じ成分からなる。また光電変換 素子に強度を付与するため、導電層10側および/または 対極導電層40側に、透明基板50a(または基板50)を設 けてもよい。以下本発明では、導電層10および任意で設 ける基板50からなる層を「導電性支持体」、対極導電層 40および任意で設ける基板50からなる層を「対極」と呼 ぶ。この光電変換素子を外部回路に接続して仕事をさせ るようにしたものが光電池である。

【0018】 未契押においては、感光波長額減の異なる 複数の感光層のすべてに光を到達させるため、光入射側 の感光層及び導電層(および必要に応じて用いるその支 持体)が実質がに光学的に透明でなければならない。ま 、その他の感光層、導電源、支持体も同様に透明であ り、上層の感光層を透過した沈が導電層を送過し下層の 感光器に至る状況が満足されていなければならない。た だし、最下層の変光層の導電皮神体は、その下層に感 光層が配置していない場合は、不透明であってもよい。 同様に、最下層が対策である場合は、対極およびその支 持体は不満明であってもよい。

【0019】図1に示す単セルにおいて、色素22により 増整された半導体微算子21を含む感光間20に入場した光 は色素22等を励起し、励起された色素22等中の高エネル ギーの電子が半導体微粒子210を場帯に渡され、さらに 拡版により等電炉10に到達する。このとき色素22等の分 子は酸化体となっている。光電池においては、導電層10 中の電子が外部時間で仕事をしながら対極弾電側がおよ び電荷移動層30を経て色素22等の酸化体に戻り、色素22 が再生する。感光層20は光アノードとして動く。それ 中間10に変元の変元の変元。 光層20と電荷移動層30との境界、電荷移動層30と対極導 電層40との境界等)では、各層の構成成分同士が相互に 拡散混合していてもよい。

【0021】ここで、積層構成の具体例を、図2から図 6に示す。図2は、ガラスのような無色透明な支持体50 aの両面に透明導電層10aを介して感光波長領域の異な る感光層20aと感光層20bが被覆され、その上層と下層 に電荷移動層30が置かれ、最上部には対極として透明導 電層40 a を担持した無色透明な支持体50 a 、最下層には 同じく対極として光反射性の不透明な対極導電層40を担 持した支持体50が配置され、これらの電極層が互いに雷 気的接合をとって精層された機造のセルである。導電層 20 の10aと40aは同じ物質であっても異なっても良い。こ のセルにおいて、光は透明な対極層の側から入射し、電 荷移動層30を透過した後に、感光層20aと感光層20bを 順次通過して最下層の対極40で反射される。ここで、感 光層は多孔質の半導体層であり、感光層20 b は感光層20 aに対してその感光波長領域がより長波長側であること が好ましく、感光層20aで吸収されなかった光は下層の 感光層20トで吸収される。電荷移動層30はセル全体を通 して共通の物質であることが好ましく、典型的には、イ オン伝導性の溶融塩が用いられる。

【0022】図3は、図2と同様な感光管20a、201を含むセルであるが、感光層で3aに同じれ積層の順が異なる。最上層は対極でなく感光層20aに同じれ積層の東が関から、その下層に電荷移動層30が層かれ、その下に、片面が透明導電層の対極40a、他の片面が透明導電層10aと感光層20を接収した透明接近0aが置かれる。それはり下は図2と同様であり、入射した光は最終的に最下層の反射性対極で反射される。図3の構成は感光層全体の光吸収物率の定り、図2の様まりも分まとい。すなわち、図2においては、入射光がはじめに電荷移動層によって一部吸収される場合があることから、集光の損失を4両の指性がある。

【0023】図4の構成は、3種の感光波長領域の異なる感光間が用いられる例である。積層の順序は基本的に図ると同じであり、感光層20bの下層に対極(40aと50a)をはさんで感光層20bが前加される。ここで、感光層20cの感光波長領域は感光層20bの感光波長領域よりも長波長側に位置することが、集光物率の点で好まし、具体的には、感光層20aは青色〜緑色の領域を、感光層20bは統色〜赤色の領域を、感光層20bは統色〜赤色の領域を、感光層20bは統色〜赤色の領域を、感光層20bは統色〜赤色の領域を、感光層20bは統色〜赤色の領域を、感光層20bは統色〜赤色の領域を、感光層20bは統色〜赤色の領域を、感光層20bは統色〜赤色の領域を、感光層20bは統色〜赤色の領域を、感光層20bは統色〜赤色の領域を、感光層20bは統色〜赤色の

外の領域に感光性を持つよう設計される。

【0024】図5は、関40報間構成に、電極の面抵抗 を滅じ環気伝導を向上させるための金属リード11を挿入 させた構成である。リード限は遺階値の狭か子状ある いは平行線状の配線パターンからなる。具体的には、総 幅が10μmから 1 mm、厚さが0.1 μmの配 域として設けられる。金属リード11は透明専電器10aも しくは透明均極40aの電気伝導を向上させる1目的で設け られ、透明等電照10aもしくは透明均極40aと電気呼に 活合した構成をとる。具体的には、金属リードは透明等 電解の内部もしくは透明均極40aと 支持体50aの間に 対よび/または透明均極47電網40aと 支持体50aの間に 環入される。このリード開本不透明であってもよる。

【0025】図6は、3種の感光波長領域の異なる感光 層と、1層の共通対極を用いた構成の例である。ガラス のような透明な支持体50aを3枚使用し、第1の支持体 50 a の下面に感光層20aを設け、第2の支持体50 a の上 面に感光層20bを設けるとともに下面に感光層20cを設 け、第3の支持体50aの上面に共通対極40を設け、前記 感光層20aと20bとの間及び、感光層20cと対極40との間 にそれぞれ電荷移動層30を充填した構成からなる。感光 層20b、第2の支持体50 a 及び感光層20cを貫通する電荷 移動用のリーク孔1aにより、感光層20a、20b、20cと対 極40とは、それぞれ電荷移動層30を介して接している。 【0026】図2から図6の基本構成において、セル性 能の改善のために各種の補助層を挿入して用いることが できる。感光層の下地として感光層と透明準雷層の間 に、下塗り層を設けることができる。さらに感光層と対 極層との間に電気的短絡防止のためのスペーサー層を設 けるなど、層構成を適宜改変することもできる。

【0027】上記の本発明の報酬型機造セルにおいて、 個々の感光層と対極の電気的結構のやりかたは、目的と する出力 (起電圧と電流)に応じてあらゆる方法が可能 であるが、好ましい方法は下配に示す結構が方法である。 また、個々の感光層の下地の透明導電電を同じく外部回 路で結合して共通アノードとする。すなわち、感光層と 対極の組合せからなる単セルが、等価回路として並列に 唇端されて観覚される相響機造型セル。

2)対極と、これと対向する感光層の下地の透明導電層 からなる個々の単セルが、等価回路として直列に結線して機成される頻層機造型セル。

【0028】図7、図8には、これらを単セル3個から なる積層構造型セルを例として、等価回路で示した。上 記の1)と2)の構成のうち、より好ましいのは並列回 路からなる1)の構成(図7)である。また、1)と 2)の配線形態(並列と直列)を両方取り入れた複合回 路も木搾削のセルに用いることができる。

【0029】上記の配線形態に関連し、積層型セルを構

4)

成する単セルの出力特性は、練層型セルの性能の安定性 を確保する目的で、以下のいずれかの条件を満たすこと が好ましい。

- ① 光アノードと対極からなる複数の単セルが、これらの単セルを積層したセルの等価回路において電気的に並列に結合され、個々の単セルが与える開放回路起電圧
- (Voc) の標準偏差が平均値に対して与える割合が15% 以内であること。
- ② 光アノードと対極からなる複数の単セルが、これら の単セルを復帰したセルの等師師路において電気的に直 10 列に結合され、個々の単セルが与える短絡光電流(1s c)の標準偏差が平均値に対して与える割合が15%以内 であること。

【0030】(B) 導電性支持体

最下層の導電性支持体以外は、光透過の必要性から透明 導電性材料を用いる必要がある。透明導電性支持体は、 透明導電配とわれを抽持する透明基板の2 解によって構 成される。透明導電層に用いる導電剤としては金属(例 えば白金、金、銀、第、アルミニウム、ロジウム、イン ジウム等)、炭素、または導電性金属酸化物(インジウ ムースズ板合酸化物、酸化ススにフッ素をドープしたも のなど)が挙げられる。このなかで光学的透明性の点か ら好ましいものは、導電性金属酸化物(特にフッ素をド ーピングした二酸化スズ! である。

[0031] 導電性支持体は表面抵抗が低い程良い。好ましい表面抵抗の範囲は100Ω/□以下であり、さらに好ましくは40Ω/□以下である。表面抵抗の下限には特に制限はないが、通常・1Ω/□程度である。

【0032】透明導電性支持体は実質的に透明であることが必要であり、400~900nmの液長範囲において、光 30 全体の透過率は、50%以上であるのが好ましく、70%以上であるのが特に好ましい。

【0033】十分な透明性を確保し、かつ、高い導電性 を持たせるために、導電性金属酸化物の途布量は支持体 1㎡当たり0.01~100gとするのが好ましい。その導電層 の厚さは0.02~10μm程度が好ましい。

【0034】透明轉電性支持体としては、ガラスまたは プラスチック等の透明基板の表面に導電性金属極化物か らなる透明導電管を塗布または蒸着等により形成したも のが好ましい。なかでもフッ素をドーピングした二酸化 40 ズガらなな導電器を低コストのソーダ石原アフロートガ ラスできた透明基板上に堆積した導電性ガラスが好ま しい。また低コストでフレキップルな水電変換奏子また は太陽電池とするには、透明ドワマーフィルムに導電管 を設けたものを用いるのがよい。透明ポリマーフィルム の材料としては、テトラアセチルセルロース(TAC)、 ポリエチレンテレフタレート (PET)、ボリエチレンナ フタレート (PEE)、シンジオタクチックポリステレン (SPS)、ポリフェニレンスルフィド (PPS)、ポリスカー 3ペネート (PC)、ポリフルニー (SPS)、ポリフェニレンスルフィド (PPS)、ポリスカー 3ペネート (PC)、ポリアルー オン (PSF) 、ボリエステルスルフォン (PES) 、ボリエ ーテルイミド (PEI)、環状ボリオレフィン、プロム化 フェノキン等がある。十分な透明性を確除するために、 導電性金属機性物の途布量はガラスまたはブラスチック の支持体 1 a 当たり0.01~100gとするのが好ましい。 【の 0 3 5 】透明導電性支持体の抵抗を下げる目的で金 属リードを用いるのが好ましい。金属リードの材質はア ルミニウム、錦、銀、金、白金、ニッケル等の金属が好ま よしく、特にアルミニウムおよび強が好ましい。金属リードは適利基底に蒸落、スパッタリング等で設置し、そ の上にフッ素をドープした酸化スズ、またはTrugpから なる透明増電限を設けるのが好ましい。また透明導電間 を透明は板に設けた後、透明等電筒上に金属リードを設 関するのも好ましい。金属リード表置による人射光量の 低下は好ましくは10%以内、より好ましくは1~5%と

【0036】 (C) 感光層

感光節において、半導体はいかめる感光体として作用 し、光を吸収して電荷分離を行い、電子と正孔を生ず る。色楽物感された半導体微粒子では、光吸収さよびこ れによる電子および正孔の発生は主として色素において 起こり、半導体微粒子はこの電子を受け取り、伝謝する 役割を担う。本発明で用いる半導体は光励起下で伝導体 電子がキャリアーとなり、アノード電流を与えるn型半 導体であることが好ましい。

【0037】(1)半導体微粒子

られる。

半導係機能子としては、シリコン、ゲルマニウムのよう な単体半導体、III-V系化合物半導体、金属のカルコゲ に下(例えば乾性)・硫化物、セレン化物等、。または ペロブスカイト構造を育する化合物(例えばチタン酸ン トロンチウム、チタン酸カルシウム、チタン酸ナトリウ ム、チタン酸バリンム、ニオブ酸カリウム等)等を使用 することができる。

【0038】好ましい金属のカルコゲニドとして、チタ ン、スズ、亜鉛、鉄、タングステン、ジルコニウム、ハ フニウム、ストロンチウム、インジウム、セリウム、イ ットリウム、ランタン、パナジウム、エオブ、またはタ ンタルの酸化物、カドミウム、亜鉛、鉛、銀、アンチモ ッまたはビスマスの硫化物、カドミウムまたは鉛のセレ ン化物、カドミウムのテルル化物等が挙げられる。他の 化合物半導体としては亜鉛、ガリウム、インジウム、カ ドミウム等のリン化物、ガリウムーと素または第一イン ジウムのセレン化物、類サーインジウムの硫化物等が挙げ

【0039】 本発明に用いる半導体の分字ましい具体例 は、S1、T10、Sn0x、Fe20、W0、Zn0、Mo20、CdS、Z NS、PUS、B15%、CdSs、CdTe、CaP、InP、CaAs、CuIn S2、CuInSer等であり、より好ましくはT10x、Zn0、Sn 0x、Fe20x、W0、Mo20、CdS、PUS、CdSs、InP、GaAs、CuInSar失行に目的をであり、特に存ましては行いまで はNb2 0s であり、最も好ましくはTi 0z である。

【0040】 本発明に用いる半導体は単結晶でも多結晶でもよい、変貌効率の組点からは単結晶が好ましいが、 製造コスト、原材料確保、エネルギーペイパックタイム 等の観点からは多結晶が好ましく、半導体微粒子からな る多れ質問が特に好まして、

【0041】半導株微粒子の栽径は一線にmーμmのオーダーであるが、投影面積を円に換算したときの直径から求めた一次粒子の平均粒径は5~200mであるのが好ましく、8~100mがより好ましい。また分散液中の半導体微粒子(二次粒子)の平均粒径は0.01~10μmが好ましい。

【0042】 粒径分布の異なる2種類以上の微粒子を混合してもよく、この場合かまい粒子の平均サイズは5mm 以下であるのが好ましい。入射光を散乱させて光掃機率 を向上させる目的で、粒径の大きな、例えば300mm程度 の半導体矩子を混合してもよい。

【0043】 半導体微粒子の件製法としては、作花済夫 の「ゾルーゲル法の科学」アグネ承風社(1988年)、技 統情報協会の「ゾルーゲル法による薄照コーティング技 20 術」(1995年)等に記載のゾルーゲル法、杉本忠夫の

「新合成法ゲルーゾル法による単分散粒子の合成とサイズ形態制御」、まてりあ、第38巻、第9号、1012~1018 買(1986年)に記載のゲルーゾル法が好ましい。またDe gussa社が開発した塩化物を酸水素塩中で高温加水分解 により酸化物を作数する方法と好ましい。

【0044】半導体微粒子が酸化チタンの場合、上記ゾル-ゲル法、ゲルーゾル法、塩化物の酸水素塩中での高温加水分解法はいずれも好ましいが、さらに清野学の

「酸化チタン 物性と応用技術」技報貸出版 (1997年) に記載の硫酸法および塩素法を用いることもできる。さ らにゾルーゲル法として、バーブらのジャーナル・オブ ・アメリカン・セラミック・ソサエティー、第80巻、第 12号、3157-317頁 [1998年] に記載の方法や、バーン サイドらのケミストリー・オブ・マテリアルズ、第10 巻、第9号、2419~2425頁に記載の方法も好ましい。 【0045】(2) 半導体板炉子層の形成

半導体微粒子を導電性支持体上に塗布するには、半導体 微粒子の分散液又はコロイド溶液を導電性支持体上に塗 布する方法の他に、前途のソルゲル法等を使用するこ ともできる。光電変換素子の重産化、半導体微粒子液の 物性、導電性支持体の能通性等を考慮した場合、湿式の 製膜方法が比較的自利である。湿式の製膜方法としては 塗布法及び用卵法が代表的できるる。

[0046] 半導体微粒子の分股液を作製する方法としては、前述のゾルゲル法の他に、乳鉢ですり潰す方 法、ミルを使って粉砕しながら分散する方法、半導体を 合成する際に溶媒中で微粒子として析出させぞのまま使 用する方法等が挙げられる。

【0047】分散媒としては、水又は各種の有機溶媒

(例えばメタノール、エタノール、イソプロピルアルコ ール、ジクロロメタン、アセトン、アセトニトリル、酢 酸エチル等)が使用可能である。分散の際、必要に応じ てポリマー、界面活性剤、酸、キレート剤等を分散助剤 として用いてもよい。

10

【0048】 徳布方法としては、アプリケーション系と してローラ法、ディップ法等、メータリング系としてエ アーナイフ法、ブレード法等、またアプリケーションと メータリングを同一部分にできるものとして、特空図83 - 4589号に開示されているワイヤーパー法、米国時許268 「294号、同2761419号、同276179号等に記載のスライド ホッパー法、エクストルージョン法、カーテン法等が好 ましい。また汎用機としてスピン法やスプレー法と好ま しい。湿式印刷方法としてスピン法やスプレー法と好ま しい。湿式印刷方法としてスピン法やスプレー法と好ま クピアの3大印刷法をはじめ、四版、ゴム版、スクリー ン印刷等が好ましい。これらの中から、液池度やウェッ ト層さに応じて、好ましい製調方法を選択する。

【0049】半導体機能子の分散液の粘度は半導体微粒 子の種類や分散性、使用溶媒種、界面活性剤やハインダ 一等の添加剤により大きく左右される。高極度強(例え ば0.01~500Polse)ではエクストルージョン法、キャス 大法、スクリーン目削熱活等が発生した。また転接度数 (例えば0.1Polse以下)ではスライドホッパー法、ワイ ヤーバー法又はスピン法が好ました、男一な限度するこ が可能である。なおある程度の途布量があれば発料度 液の場合でもエクストルージョン法による途中は可能 ある。このように途布液の粘度、塗布量、支持体、塗布 建度等に応じて適宜循式製販方法を選択すればよい。

【0050】半導体機能子の層は単層に限らず、粒径の 違った半導体機能子の分散液を多層造布したり、種類が 異なる半導体機能子(痰かは異なるバインダー、添加 剤)を含有する塗布層を多層塗布したりすることもでき る。一度の塗布で膜原が不足の場合にも多層塗布は有効 である。多層塗布にはエクストルージョン法又はスライ ドホッパー法が適している。また多層塗布をする場合は 同時に多層を塗布してもよく、数回から十数回原次重ね 塗りしてもよい。さちに順次重は速りする場合にはスク リーン回廊技术がまた。

【0051】一般に半導体微粒子層の厚さ(感光層の厚さと同じ)が呼くるなめ、光の捕獲や許高くなめ、光の捕獲や許高くなるが、生成した電子の拡散距離が増すため電信申結合によるロスも大きくなる。したがつて、各光アノードの半導体機能子層の貯ましい。その大変をある。光入射の反対側の最下層以外の層は、光要収を行うとともに光を透過させる必要があるので、半等体機粒子層の厚さは、1~10μmが好ましく、2~9μmがより算ましく、4~7μmがさらに好ましい。最下層はたれより厚くでも構わない。各光アノードにおいて、半導体機粒子の支持体1㎡当たり発作は1㎡3~3~20mがましく。3~12mがより背よし、4~3~2mが

14002 001 010

1.5

[0052] 半導体機能子を審定性支持体上に塗布した 後で半導体機能子間土を電子的に接触させるとともに、 業態強値の向上や支持体との電影性を向上させるため に、加熱処理するのが好ましい。好ましい加熱温度の範 囲はむで以上700で未満であり、より好ましくは100で以 た600で以下である。また加熱細胞は0分~100階間和度 である。ボリマーフィルムのように触点や軟化点の低い 支持体を用いる場合、高温処理は支持体の多化を招くた め好ましくない。またコストの組むからもできる股り低 10 温であるのが好ましい。低温化は先に述べた5mm以下の 小さい半導体微症子の併用や敵機の存在下での加熱処理 等により可能となる。

【0053】加熱処理後半導体微粒子の表面積を増大さ せたり、半導体微粒子近傍の軸便を高め色素から半導体 粒子への電子注入効率を高める目的で、例えば四塩化チ タン水溶液を用いた化学メッキや三塩化チタン水溶液を 用いた電気化学的メッキ処理を行ってもよい。

【0054】半導体徴粒子は多くの色素を吸着することができるように表面観り大きいものが好ましい。このた 20 必半導体機能子の層を支持体上に能布した状態での表面 組は、投影面能に対して10億以上であるのが好ましく、さらに100億以上であるのが好ましく。この上限は特に 制限はないが、通常1000倍度程である。

【0055】(3)色素

原光層に用いる増感色素としては、有機金属樹体色素、 メチン色素、ポルフィリン系色素、プタロンプニン系色 素が好ましい、光電変換の波長域をできるだけなくし、 かつ変換効率を上げるため、一種類以上の色素を混合す ることができる。また目的とする光源の波長域と強度分 20 布に合わせるように、混合する色素とその割合を選ぶこ とができる。 【0 05 6】こうした色素は半導体微粒子の表面に対する適当な結合態(interlocking group)を有しているのが好ましい。 歩ましい結合量としては、60001基、08基、50x1基、シアノ基、-P(0) (00)2基、-OP(0) (00)2基、またはオキシム、ジオキシム、ヒドロキシキノリン、サリナレートおよびα-ケトエノレートのようなπ伝薄性を有するキレート化基が挙げられる。なかでも0001基、-P(0) (00)2基、つP(0) (00)2基が特に存ました。これらのは対したいかり、一般はアルカリ金属等と塩を形成していてもよく、また分子内塩を形成していてもよい。またボリメチン色素の場合、メチン鎖がスクアリリウム間やクロコニウム間を形成する場合のように酸性基を合作するなら、この部分を結合としてもよい。

12

【0057】以下、感光層に用いる好ましい色素を具体 的に説明する。

【0058】 (a) 金属錯体色素

【0059】さらに本発明で用いるルテニウム錯体色素 は下記一般式(1):

(A1)_p Ru(B-a) (B-b) (B-c) · · · (1)

により表されるのが好ましい。一般式 (I) 中、AiはC 1、SCN、IzO、Br、I、CN、NCOおよびSeCNからなる群か ら選ばれた配位子を表し、pは0~3の整数である。Ba、B-bおよびB-cはそれぞれ独立に下記式B-1~B-10: 【0060】

[(k:1)]

【0061】 (ただし、Rn は水素原子または置換基を 表し、置換基としてはたとえば、ハロゲン原子、炭素原 子数1~12の置換または無置換のアルキル基、炭素原子 教7~12の置換または無置換のアラルキル基。あるいは 炭素原子数6~12の間換または無置換のアリール基、カ ルボン酸基、リン酸基 (これらの酸基は塩を形成してい 40 すが、本発明はこれらに限定されるものではない。 てもよい) が挙げられ、アルキル基およびアラルキル基 のアルキル部分は直鎖状でも分岐状でもよく、またアリ

ール基およびアラルキル基のアリール部分は単環でも多 環(縮合環、環集合)でもよい。)により表される化合 物から選ばれた有機配位子を表す。B-a、B-bおよびB-c は同一でも異なっていても良い。

【0062】金属錯体色素の好ましい具体例を以下に示 [0063] 【化2】

(9) 特開2001-319698

	(0)			TO U L O U I	313030
15			16		
	(A ₁) _n Ru(B-a)(B-b)(B-c)	· · · (1)			

	A ₁	Р	В-а	B-b	B-c	Rit
R-1	SCN	2	B-1	B-1		_
R-2	CN	2	B-1	B-1	-	-
R-3	CI	2	B-1	B-1	_	_
R-4	CN	2	B-7	B-7	-	_
R-5	SCN	2	B-7	B-7	-	-
R-6	SCN	2	B-1	B-2	-	н
R-7	SCN	1	B-1	B-3	_	-
R-8	CI	1	B-1	B-4	-	н
R-9	1	2	B-1	B-5	_	н
R-10	SCN	3	B-8	-	_	-
R-11	CN	3	B-8	-	_	-
R-12	SCN	1	B-2	B-8	-	н
R-13	_	0	B-1	B-1	B-1	_

[0064] [他3]

R-15

R-16

[0065]

R-19

R-18

20

【0066】(b) メチン色素

本発明に使用する色素の好ましいメチン色素は、シアニ ン色素、メロシアニン色素、スクワリリウム色素などの ポリメチン色素である。これらの中では、メロシアニン 色素とスクアリリウム色素が好ましい。

【0067】これらの色素の合成法については、エフ・エム・ハーマー(F.R. Hamer)著「ヘテロサイクリック・ コンパウンズーシアニンダイズ・アンド・リレィティド・コンパウンズ(Heterocyclic Compounds-Cyanine Dyes and Related Compounds)」、ジョン・ウィリー・アン ド・サンズ(John Wiley & Sons)社ーニューヨーク、ロ ンドン、1964年刊、デー・エム・スターマー(D.M.S turnec)著「ヘテロサイクリック・コンパウンズースペ シャル・トピックス・イン・ヘテロサイクリック・ケミ ストリー(Rictorcyclic Compounds Special topics in heterocyclic chemistry)」、第18章、第14節、第482か 5515頁、ジョン・ウィリー・アンド・サンズ(John 町 ley & Sons)社ーニューヨーク、ロンドン、1977年刊、 「ロッズ・ケミストリー・オア・カーボン・コンパウン ズ(Rodd s Chemistry of Carbon Compounds)」 2nd Ed. v ol. IV, part B, 1977刊、第15章、第369から422頁、エル セピア・サイエンス・ハブリック・カンパニー・インク (Elsevier Science Publishing Company Inc.) 社刊、ニ ューヨーク、英国特許第1,077.611号、Ukrainskii Khim icheskii Zhurnal、第40巻、第3号、252~258頁、Dyes and Pigments、第21巻、227~234頁およびこれらの文 献に引用された文献になどに記載されている。

【0068】この他、フタロシアニンおよびサフタロシアニンとをの誘導体、金属フタロシアニン、金属フフタロシアニンをの誘導体、テトラフェニルボルフィリン 10 やテトラアザボルフィリンを含むボルフィリン類とその誘導体、金属ボルフィリンとその誘導体、なども好ましく用いることができる。さらに、色素レーザー用に用いられる色素類も本発明に用いることができる。

【0069】(4)半導体微粒子への色素の吸着 半導体微粒子に色素を吸着させるには、色素の溶液中に 良く乾燥した半導体微粒子層を有する導電性支持体を浸 漬するか、色素の溶液を半導体微粒子層に塗布する方法 を用いることができる。前者の場合、浸漬法、ディップ 法、ローラ法、エアーナイフ法等が使用可能である。な 20 お浸漬法の場合、色素の吸着は室温で行ってもよいし、 特開平7-249790号に記載されているように加熱環流して 行ってもよい。また後者の塗布方法としては、ワイヤー バー法、スライドホッパー法、エクストルージョン法、 カーテン法、スピン法、スプレー法等があり、印刷方法 としては、凸版、オフセット、グラビア、スクリーン印 刷等がある。溶媒は、色素の溶解性に応じて適宜選択で きる。例えば、アルコール類(メタノール、エタノー ル、t-プタノール、ベンジルアルコール等)、ニトリル 類(アセトニトリル、プロピオニトリル、3-メトキシプ 30 ロピオニトリル等)、ニトロメタン、ハロゲン化炭化水 素(ジクロロメタン、ジクロロエタン、クロロホルム、 クロロベンゼン等)、エーテル類(ジエチルエーテル、 テトラヒドロフラン等)、ジメチルスルホキシド、アミ ド類 (N,N-ジメチルホルムアミド、N,N-ジメチルアセタ ミド等)、N-メチルピロリドン、1,3-ジメチルイミダゾ リジノン、3-メチルオキサゾリジノン、エステル類(酢 酸エチル、酢酸プチル等)、炭酸エステル類(炭酸ジエ チル、炭酸エチレン、炭酸プロピレン等)、ケトン類 (アセトン、2-プタノン、シクロヘキサノン等)、炭化 40 水素(ヘキサン、石油エーテル、ベンゼン、トルエン

【0 0 7 0 】色素の溶液の基底についても、半導体機を 予層の形成時と同様に、高結度流(例えば0.01〜500Pol sa)ではエンストルージョン法の他に各種間期法が適当 でおり、また低粘度流(例えば0.1Polse以下)ではスラ イドホッパー法、ワイヤーパー法またはスピン法が適当 であり、いずれも均一な限止することが可能である。

等) やこれらの混合溶媒が挙げられる。

【0071】このように色素の塗布液の粘度、塗布量、 導電性支持体、塗布速度等に応じて、適宜色素の吸着方 50 22 法を選択すればよい。塗布後の色素吸着に要する時間 は、量産化を考えた場合、なるべく短い方がよい。

【0072】未吸着の色素の存在は素子性能の外乱にな なため、吸着後速やかた洗浄により除去するのが好まし い。温式洗浄槽を使い、アセトニトリル等の極性溶剤、 アルコール系溶剤のような有機溶媒で洗浄を行うのが好ま ましい。また色素の吸着量を増大させるため、吸着前に 加熱処理を行うのが好ましい。加熱処理後、半導体微粒 ア表面に水が吸着するのを避けるため、常温に戻さずに 40~80℃の間で素早く色素を吸着させるのか好ましい。

【0073】色素の全使用量は、導電性支持体の単位表 面積(1 m²) 当たり0.01~100mmの1が算ましい。また色 悪の半導体験が子に対する要が発は、半導体機能子1g 当たり0.01~1 mmo1であるのが好ましい。このような色 素の吸着量とすることにより、半導体における地密効果 が十分に得ったる。これに対し、色素が少なすざると増 感効果が不十分となり、また色素が多すざると、半導体 に付着していない色素が浮遊し、増感効果を低減させる 原因となる。

【0074】会合のような色素同士の相互作用を低減する目的で、無色の化合物を半導体微粒子に共吸着させて もい、共吸管させる液体性合物としては力がポーシ ル基を有するステロイド化合物(例えばケノデオキシコ ール酸、等が挙げられる。また繋外線吸収剤を併用する こともできる。

【0075】余分な色素の除去を促進する目的で、色素 を吸着した後にアミン類を用いて半導体機粒子の表面を 処理してもよい。好ましいアミン類としてはゼリジン、 4-t-ブチルゼリジン、ボリビニルゼリジン等が挙げられ る。これらが液体の場合はそのまま用いてもよいし、有 機溶媒に溶解して用いてもよい。

【0076】 (D) 電荷移動層

電商移動層は色素の酸化体に電子を構充する機能を有す 電荷輸送材料を含有する層である。本発明で用いる とのできる代表的な電荷輸送材料の例としては、①イオ ン輸送材料として、酸化週元材のイオンが溶解した溶液 (電解剤)、酸化週元材の溶液をボリマーマトリクスの グルに含浸したいわゆるグル電解質、酸化週元材イン を含有する溶機塩電解質、さらには固体電解質が挙げられる。また、イオンがかかわる電荷輸送材料のほかに、 ②固体中のキャリア・移動が運気伝導にかかる材料と して、電子輸送材料や正孔(ホール)輸送材料を用いる こともできる。これらは、併用することができる。 【0077】(1) 浴路塩溶解質

溶離塩脂解質は、光電変換効率と耐久性の両立という観点から好ましい。本発明の光電変換素子に溶離塩電解質を用いる場合は、例えば005/18456号、特間界8 259543 号、電気化学、第65巻、11号、923頁(1997年)等に記載されているビリジニウム塩、イミダンリウム塩、トリアソリウム塩等の原質のコツ東塩を用いることができ

Ζ.

【0078】好ましく用いることのできる溶離塩として は、下記一般式 (Y-a) 、 (Y-b) 及び (Y-c) のいずれ

かにより表されるものが挙げられる。

[0079]

【化5】

$$R_{y2}$$
 A_{y1} R_{y4} A_{y4} A_{y4} A_{y5} A_{y5}

$$R_{y_1}$$
 R_{y_2} R_{y_6} R_{y_6} R_{y_6} R_{y_6} R_{y_6} R_{y_6} R_{y_6} R_{y_6} R_{y_6} R_{y_6}

【0080】一般式 (Y-a) 中、Qu は窒素原子と共に5 又は6員環の芳香族カチオンを形成しうる原子団を表 す。Qri は炭素原子、水素原子、窒素原子、酸素原子及 び硫黄原子からなる群から選ばれる1種以上の原子によ り構成されるのが好ましい。

【0081】0x1 により形成される5員環は、オキサゾ ール環、チアゾール環、イミダゾール環、ピラゾール 環、イソオキサゾール環、チアジアゾール環、オキサジ アゾール環又はトリアゾール環であるのが好ましく、オ キサゾール環、チアゾール環又はイミダゾール環である のがより好ましく、オキサゾール環又はイミダゾール環 であるのが特に好ましい。0/1 により形成される6員環 は、ピリジン環、ピリミジン環、ピリダジン環、ピラジ ン環又はトリアジン環であるのが好ましく、ピリジン環 であるのがより好ましい。

【0082】一般式 (Y-b) 中、Avi は窒素原子又はリン 原子を表す。

【0083】 一般式 (Y-a) 、 (Y-b) 及び (Y-c) 中のR vi ~R.6 はそれぞれ独立に置換又は無置換のアルキル基 (好ましくは炭素原子数1~24、直鎖状であっても分岐 状であっても、また環式であってもよく、例えばメチル 基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ペンチル 基、ヘキシル基、オクチル基、2-エチルヘキシル基、t-オクチル基、デシル基、ドデシル基、テトラデシル基。 2-ヘキシルデシル基、オクタデシル基、シクロヘキシル 基、シクロペンチル基等)、或いは置換又は無置換のア

っても分岐状であってもよく、例えばピニル基、アリル 基等)を表し、より好ましくは炭素原子数2~18のアル キル基又は炭素原子数2~18のアルケニル基であり、特 に好ましくは炭素原子数2~6のアルキル基である。 【0084】また、一般式 (Y-h) 中のRu ~Ru のうち 2つ以上が互いに連結してAvi を含む非芳香族環を形成 30 してもよく、一般式 (Y-c) 中のR_M ~R₆ のうち 2 つ以 上が互いに連結して環構造を形成してもよい。 【0085】 一般式 (Y-a) 、 (Y-b) 及び (Y-c) 中の0

v1 及びRv1 ~Rv6 は置換基を有していてもよく、好ましい 置換基の例としては、ハロゲン原子(F、CI、Br、I 等)、シアノ基、アルコキシ基(メトキシ基、エトキシ 基等)、アリーロキシ基(フェノキシ基等)、アルキル チオ基(メチルチオ基、エチルチオ基等)、アルコキシ カルボニル基(エトキシカルボニル基等)、炭酸エステ ル基(エトキシカルボニルオキシ基等)、アシル基(ア 40 セチル基、プロピオニル基、ベンゾイル基等)、スルホ ニル基(メタンスルホニル基、ベンゼンスルホニル基 等)、アシルオキシ基(アセトキシ基、ベンゾイルオキ シ基等)、スルホニルオキシ基(メタンスルホニルオキ シ基、トルエンスルホニルオキシ基等)、ホスホニル基 (ジエチルホスホニル基等)、アミド基(アセチルアミ ノ基、ベンゾイルアミノ基等)、カルバモイル基(N,N-ジメチルカルパモイル基等)、アルキル基(メチル基、 エチル基、プロピル基、イソプロピル基、シクロプロピ ル基、プチル基、2-カルボキシエチル基、ベンジル基 ルケニル基(好ましくは炭素原子数2~24、直鎖状であ so 等)、アリール基(フェニル基、トルイル基等)、複素 25 環基(ビリジル基、イミダゾリル基、フラニル基等)、 アルケニル基(ビニル基、1-プロベニル基等)等が挙げ られる。

【0086】一般式(Y-a)、(Y-b)又は(Y-c)により表される化合物は、 Q_1 又は $R_{N1}\sim R_{N6}$ を介して多量体を形成してもよい。

【0087】これらの溶融塩は、単独で使用しても、2 種以上混合して使用してもよく、また、ヨウ素アニオン を他のアニオンで置き換えた溶融塩と併用することもで きる。ヨウ素アニオンと置き換えるアニオンとしては、 ハロゲン化物/オン(CI・、Br・等)、NSC・BF・、P

[0090]

Fe⁻、C1Or⁻、(CF25Dr) 2 ^{*}/*、(CF2 CF2 5Dr) 2 ^{*}/*、(CF3 CDr) 2 ^{*}/*、(CF3 CDr) 2 ^{*}/*、等が発化しい例として挙げられ、(CF2 SDr) 2 ^{*}/* 又はBF1 であるのがより好ましい。また、LiIなど他のヨウ素塩を添加することもできる。

26

【0088】本発明で好ましく用いられる溶融塩の具体 例を以下に挙げるが、これらに限定されるわけではない。

【0089】 【化6】

[0091] [作8]

(Y13) X: X: N N N C H (r) Y13-1 X=I Y13-2 X=BF₄ Y13-3 X=N(SO₂CF₃)₂

30

(Y14)
$$H_3C^{-N} \stackrel{N^*}{\sim} C_4H_9(n)$$

Y14-1 X=I Y14-2 X=BF₄ 4H₉(n) X Y14-3 X=N(SO₂CF₃)₂

(Y15)
$$N^{+}C_{6}H_{13}(n)$$

Y16-1 X=I Y16-2 X=BF₄ Y16-3 X=N(SO₂CF₃):

Y17-1 X=I Y17-2 X=BF₄ Y17-3 X=N(SO₂CF₃)₂

40

 CH_2CH_3 Y18) CH_3CH_2 — $N^{+}_{-}C_4H_9(n)$ X^{-} Y18-1 X=IY18-2 $X=BF_4$

Y18-3 X=N(SO₂CF₃)₂ Y18-4 X=PF₆

32

Y18-4 X=F

CH₂CH₃ Y19-1 X=I (Y19) H₃C−N[±]−(CH₂CH₂O)₂CH₃ X Y19-2 X=BF₄ CH₂CH₃ Y19-3 X=N(SO₂CF₃)₂

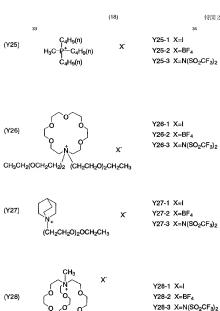
(Y20) (CH₂CH₂O)₂CH₃ Y20-1 X=I CH₃(OCH₂CH₂)₂−N^{±−}(CH₂CH₂O)₂CH₃ X Y20-2 X=BF₄ (CH₃CH₃O)₃CH₃ Y20-3 X=N(SO₂CF₃)₂

(Y22) CH₂CH₂ Y22-1 X=I (Y22) CH₃CH₂ Y-CH₂CH₂O-X X Y22-2 X=BF₄ (Y22-3 X=N(SO₂CF₃)₂

CH₂CH₃ Y22-3 X=N(SO₂CF₃)₂

Y23-1 X=I Y23-2 X=BF₄ Y23-3 X=N(SO₂CF₃)₂

[0093] [化10]



ÖH₃ [0094] [代11]

40

X.

[0095] [化12]

Y36-1 X=I Y36-2 X=N(SO₂CF₃)₂

[0096]上記溶機塩電粉質には、溶媒を用いない方 が好すよい。後述する溶媒を添加しても構わないが、溶 酸塩の含有限は電粉質組成物全体に対して50質質等以上 であるのが好ましい。また、塩のうち、50質量%以上が ヨウ素塩であることが好ましく、70%以上であることが さらに好ましい。

【0097】電解質組成物にヨウ素を添加するのが好ま しく、この場合、ヨウ素の含有重は、電解質組成物全体 に対して0.1~20質量%であるのが好ましく、0.5~5質 量%であるのがより好ましい。

【0098】(2)電解液

電荷移動層に電解液を使用する場合、電解液は電解質、 どの金属錯体、ポリ硫化ナトリウム、アルキルチオール 溶媒、および添加物から構成されることが好ましい。本 50 -アルキルジスルフィドなどのイオウ化合物、ビオロゲ

Y36-3 X=BF4

ン色素、ヒドロキノンーキノンなどを用いることができる。この中でも12と1、11やビリジニウムヨーダイド、 イミダゾリウムヨーダイドなど4数アンモニウム化合物のヨウ素塩を組み合わせた電解質が本発明では好ましい。 上述した電解質は混合して用いてもよい。

【0099】好ましい電解質濃度は0.1M以上15M以下であり、さらに好ましくは0.2M以上10M以下である。また、電解質にヨウ素を添加する場合の好ましいヨウ素の添加濃度は0.0M以上0.5M以下である。

【0100】本発明で電解質に使用する溶媒は、粘度が 低くイオン移動度を向上したり、もしくは誘電率が高く 有効キャリアー濃度を向上したりして、優れたイオン伝 導性を発現できる化合物であることが望ましい。このよ うな溶媒としては、エチレンカーボネート、プロピレン カーボネートなどのカーボネート化合物、3-メチル-2-オキサゾリジノンなどの複素環化合物、ジオキサン、ジ エチルエーテルなどのエーテル化合物、エチレングリコ ールジアルキルエーテル、プロピレングリコールジアル キルエーテル ポリエチレングリコールジアルキルエー テル、ポリプロピレングリコールジアルキルエーテルな 20 どの鎖状エーテル類、メタノール、エタノール、エチレ ングリコールモノアルキルエーテル、プロピレングリコ ールモノアルキルエーテル、ポリエチレングリコールモ ノアルキルエーテル、ポリプロピレングリコールモノア ルキルエーテルなどのアルコール類、エチレングリコー ル、プロピレングリコール、ポリエチレングリコール、 ポリプロピレングリコール、グリセリンなどの多価アル コール類、アセトニトリル、グルタロジニトリル、メト キシアセトニトリル、プロピオニトリル、ベンゾニトリ ルなどのニトリル化合物、ジメチルスルフォキシド、ス 20 ルフォランなど非プロトン極性物質、水などを用いるこ とができる。

[0 1 0 1] また、本発明では、J・Am. Ceram. Soc. ... 多の (12)3157-3171 (1997) た記載されているようなモーブ チルビリジンや、2-ビコリン、2.6-ルチジン等の塩基性 化合物を添加することもできる。塩基性化合物を添加す る場合の好ましい濃度変調はの.05M以上2M以下である。 「0 1 0 2 1 (3) ゲル治電気

本発明では、電解質はポリマー添加、オイルゲル化剤添加、多官能モノマー類を含む重合、ポリマーの架橋反応 40 等の手法によりゲル化 (個体化) させて使用することも できる。ポリマー添加によりゲル化させる場合は、"Po lymer Electrolyte Reviews-Hネよでダ" (J.R.MacCallum とC.A. Vincentの共編、EISEVIE APPLIED SIEEKIE) に 記載された化合物を使用することができるが、特にポリ アクリロニトリル、ポリフッ化ビニリデンを好ましく使 用することができる。オイルゲル化剤添加によりゲル化 させる場合はJ. Chem Soc. Japan, Ind. Chem.Sec., 4 6,779(1943)、J. Am. Chem. Soc., 11,5542(1989)、J. Sochem. Soc., home. Com sun., 1993、390、J. Mancew. Che m. Int. Ed. Engl., 35,1949(1996), Chem. Lett.,199 6, 885, J. Chm. Soc., Chem. Commun., 1997,545に記 載されている化合物を使用することができるが、好まし い化合物は分子構造中にアミド構造を有する化合物であ る。

【0103】また、ポリマーの架橋反応により電解質を

40

ゲルにさせる場合、架橋可能な反応性基を含むするボリ
つーおよび架橋神を併用することが望ましい。この場
合 好ましい架備神を併用することが望ましい。この場
合 好ましい架岬前能な反応性球は、含窒素製業環(例
えば、ピリジン環、イミダゾール環、チアゾール環、オーナゾール環、トリアゾール環、シェルリン環、ピベリ
ンの環、ピベラジン環など)であり、好ましい架橋剤は、窒素原子に対して米電子反応可能な2官能以上の試
薬 (例えば、ハロゲン化アルチル、ハロゲン化アラルキル、スルホン機なエチアル、機能大物、酸クロララは、イ

ソシアネートなど) である。 【0104】(4) 正孔輸送材料

本発明では、電解質の替わりに有機または無機あるいは この両者を組み合わせた正孔輸送材料を使用することが できる。

【0105】(a) 有機正孔輸送材料

本発明に適用可能な有機正孔輸送材料としては、N.N.-ジフエニル-N、N -ピス (4-メトキシフェニル) - (1. 1 -ピフェニル) -4, 4 -ジアミン(J.Hagenet al., Synth etic Metal 89(1997)215-220) 、2,2 ,7,7 -テトラキス (N.N-ジ-p-メトキシフェニルアミン) 9.9 -スピロビフ ルオレン (Nature, Vol. 395, 8 Oct. 1998, p583-585およ びW097/10617)、1,1-ピス (4- (ジ-p-トリルアミノ) フェニル〉シクロヘキサンの3級芳香族アミンユニット を連結した芳香族ジアミン化合物 (特開昭59-194393号 公報)、4.4. - ビス「(N-1-ナフチル) - N-フェニル アミノ] ビフェニルで代表される2個以上の3級アミン を含み2個以上の縮合芳香族環が窒素原子に置換した芳 香族アミン (特開平5-234681号公報) 、トリフェニル ベンゼンの誘導体でスターパースト構造を有する芳香族 トリアミン (米国特許第4,923,774号、特開平4-3086 88号公報)、N, N -ジフエニル-N、N -ビス (3-メチル フェニル) - (1. 1 -ピフェニル) -4. 4 -ジアミン等の 芳香族ジアミン (米国特許第4, 764, 625号)、α. α. α . α -テトラメチル-α. α -ビス (4-ジ-p-ト

4. a. a. 7ドンケンル・a. a. ことへ (キン・p・) リルアミノフェニル)・p・キシ・レン (特間等・20508年) 公銀、p・フェニルンジアミン高導体、分子全体として立体的に非対称なトリフェニルアミン高導体、分子全体として立体的に非対称なトリール基に分看族ジアミノ基が複数解解後した化合物(特別平4ー17530号公報)、エチレン基で3数分香族アミンユニットを連結した芳香族ジアミン(特別平4ー20181号公報)、スチリル構造を有する芳香族ジアミン(特別平4ー20181号公報)、ステリル構造を有する芳香族ジアミン(特別平4ー20181号公報)、スワルオレン基で破水アミンを測器したもの(特別平5ー26473

号公領)、トリアミン化合物 (特開平5 - 239455号公 能)、ヒスジピリジルアミノピフェニル (特開平5 - 320 634号公報)、N. N. N - トリフェニルアミン誘導体 (特 開平6 - 1912号公報)、フェノキザジン構造を有する芳 香族ジアミン (特間平7 - 138562号)、ジアミノフェニル フェナントリジン誘導体 (特開平7 - 252474号) 等にこれ れる芳香旅アミン 紅を好ましく用いることができる。

- ジヘキシル- α-オクチルチオフェン (Adv. Mater. 199 7,9,NO.7,p557)、ヘキサドデシルドデシチオフェン(Ang 10 ew.Chem. Int. Ed. Engl. 1995, 34, No.3,p303-307), 2,8-ジヘキシルアンスラ[2,3-b:6,7-b]ジチオフェン(J ACS, Vol120, NO.4, 1998, p664-672) 等のオリゴチオフェ ン化合物、ポリピロール (K. Murakoshi et al..:Chem. Lett. 1997, p471) , " Handbook of Organic Conduct ive Molecules and Polymers Vol.1,2,3,4" (NALWA著、 WILEY出版) に記載されているポリアセチレンおよびそ の誘導体、ポリ(p-フェニレン) およびその誘導体、ポ リ(n-フェニレンビニレン) およびその誘導体 ポリチ エニレンビニレンおよびその誘導体、ポリチオフェンお 20 よびその誘導体、ポリアニリンおよびその誘導体、ポリ トルイジンおよびその誘導体等の導雷性高分子を好まし く使用することができる。

【0 1 0 7】正孔(ホール)輪送材料にはkature、vol. 3 55、8 0 ct. 1998, p583-585に記載されているようにドー バントレベルをコントロールするためにトリス(4-ブ ロモフェニル)アミニウムへキサクロロアンチモネート のようなカチナシラジカルを含有する化合物を添加した り、酸化物半導体表面のボテンシャル制脚(空間電荷層 の補償)を行うためにLI((CF3 SO 2) 2 N)のような塩を 添加しても嫌わない。

【0108】(b)無機正孔輸送材料

無機正孔輸送材料としては、p型無機化合物半導体を用 いることができる。この目的の p型無機化合物半導体 は、バンドギャップが2eV以上であることが好ましく、 さらに2.5eV以上であることが好ましい。また、p型無 機化合物半導体のイオン化ポテンシャルは色素の正孔を 環元できる条件から、色素吸着電極のイオン化ポテンシ ャルより小さいことが必要である。使用する色素によっ て p 型無機化合物半導体のイオン化ポテンシャルの好ま 40 しい範囲は異なってくるが、一般に4.5eV以上5.5eV以下 であることが好ましく、さらに4.7eV以上5.3eV以下であ ることが好ましい。好ましい p型無機化合物半導体は一 価の銅を含む化合物半導体であり、一価の銅を含む化合 物半導体の例としてはCuI, CuSCN, CuInSe2, Cu(In,Ga) Sez, CuGaSez, CuzO, CuS, CuGaSz, CuInSz, CuA1Sez A どが挙げられる。この中でもCulおよび CuSCNが好まし く、CuIが最も好ましい。このほかのp型無機化合物半 導体として、GaP、NiO、CoO、FeO、Bi2O3、MoO2、Cr2O3 等を用いることができる。

【0 1 0 9 】 p型無機化合動生率体を含有する電荷移動 層の好ましいホール移動度は10 - 'cm' / v - sec以上10 'cm ² / v - sec以下であり、さらに好ましくは10 - 3 cm' / v - se に以上10 'cm' / v - sec以下である。また、電荷移動層の好ましい物理事様は10 - 'S/cm以上10 'S/cm以下であち)、さら に好ましくは10 - S/cm以上10 / sm以下である)、さら に好ましくは10 - S/cm以上10 / sm以下である。

42

【0110】(5)電荷移動層の形成

電荷移動柄の形成方法に関してはと適りの方法が考えら れる。1つは増感色素を担持させた半導体微性子含有層 の上に先に対極を貼り合わせておき、その間際に流状の 電荷移動層を挟み込む方法である。もう1つは半導体微 粒子含作層上に直接道路移動層を付与する方法で、対極 はその移付生することになる。

【0111】 前者の場合の電荷移動層の挟み込み方法と して、浸清等による毛管現象を利用する常圧プロセスと 管圧より低い圧力にして気相を液相に置換する真空プロ セスが利用できる。

【0112】後者の場合、温火の電荷移動層においては 未乾燥のまま対極を付与し、エッジ部の溶油液防止措置 も縮すことになる。またゲル電解質の場合には超式で塗 布して重合等の方法により固体化する方法もあり、その 場合には乾燥、固定化した後に対極を付ちすることもで さる。電解液のほか超式有機正不確送材料やゲル電解質 を付ちて高方法としては、半導体微粒子含有層や色素の 付ちと同様に、設徴法、ローラ法、ディップ法、エアー ナイフ法、エクストルージョン法、スライドホッパー 法、ワーヤーバー法、スピン法、スプレー法、キャスト た。条線和間を表体なくちな、スプレー法、キャスト た。条線和間等を持なきくちな、

【0113】 固体電解質や固体の正孔(ホール) 輸送材料の場合には東空蒸着法やCVD法等のドライ成膜処理 料の場合には東空蒸着法やCVD法等のドライ成膜処理 で電荷移動層を形成し、その後板を付与することもできる。有機正孔輸送材料は真空蒸着法、キャスト法、塗 市法、スピンコート法、浸渍法、電解重合法、光電解車 合法等の手法により電極内部に乗りまることができる。 無機固体化合物の場合も、キャスト法、塗布法、スピン コート法、浸渍法、電解メッキ法等の手法により電極内 部に導入することができる。

【0 11 4】 量産化を考える場合、固体化でをない電解 歳や温式の正孔輸送材料の場合には、塗設後速やかにエ ップ部分を封止することで対応ら可能であるが、固体化 可能な正孔輸送材料の場合は罷式付ちにより正孔輸送例 を膜形成した後、例えば光重合や熱ラジカル重合等の方 法により関係化することがより好ましい。このように膜 付与方式は減物性や工起条件により適宜選択すればよ

【0115】なお、電荷移動層中の水分としては10,000 ppm以下が好ましく、さらに好ましくは2,000ppm以下で あり、特に好ましくは100ppm以下である。

【0116】 (E) 対極

50 対極は、光電変換素子の正極として作用するものであ

 最下層の対極以外は、光透温の必要性から前述の導 雷性支持体と同様の透明導雷性材料を用いる必要があ る。対極導雷層に用いる導雷材としては、金属(例えば 白金、金、銀、銅、アルミニウム、マグネシウム、ロジ ウム、インジウム等)、炭素、または導電性金属酸化物 (インジウム-スズ複合酸化物、酸化スズにフッ素をド ープしたもの等)が挙げられる。この中でも白金、金、 銀、銅、アルミニウム、マグネシウムを対極層として好 ましく使用することができる。対極の好ましい支持基板 の例は、ガラスまたはプラスチックであり、これに上記 10 の導電剤を塗布または蒸着して用いる。対極導電層の厚 さは特に制限されないが、3nm~10μmが好ましい。対 極導電層が金属製である場合は、その厚さは好ましくは 5 μm以下であり、さらに好ましくは 5 nm~ 3 μmの範囲 である。対極層の表面抵抗は低い程よい。好ましい表面 抵抗の範囲としては80Ω/□以下であり、さらに好まし くは20Ω/□以下である。

【0117】対極は、電荷移動層上に直接導電料を塗 市、メッキまたは蒸着(PP)、CPD するか、導電器を有 する基板等準型側を貼り付ければよい。また、導電性 支持体の場合と同様に、特に対極が透明の場合には、対 極の抵抗を下がる目的で金属リードを用いるかが戻まし い。なお、好ましい金属リードの材質および設置方法、 金属リード設置による人材光理の低下等は導電性支持体 の場合と同じである。

[0 1 1 8] 最下層の対権(対権より下、すなわち光入 射面の反対側に感光層がない場合) は不透明であっても 良い、光の排機率を高める眼点からは、最下層の対極は 光反射性が大きい程好ましい。最下層の対極は、導電性 材料からなる対極導電面の単層構造でもよいし、対極等 30 電電と支持基板から構成されていてもよい。

【0119】 (F) その他の層

電荷移動態と電子輸送材料や正孔輸送材料を用いる場合、対極と導電性支持体の短絡を防止するため、予め導電性支持体と感光層の間に振密な半導体の薄膜障を下塗り層として好ましいの注110g、50dg、Feetos、Wos、200、Nac0cであり、さらに好ましくは710gである。下塗り層はElectrochini, Acta 40, 643-652 (1995) に記載されているスプレーバイロリシス法により塗設することができる。下塗 40 り層の好ましい服厚は5~1000mm以下であり、10~500mm がさらに好ましい。

【0120】また、電極として作用する導電性支持体および対極の一方法では両方に、保護際、反射筋止層等の機能性層を設けても良い。このような機能性層を層に形成する場合、同時を同望命治を必要な確由法を利用できるが、生産性の観点からは同時を層望布法が好ましい。同時を開室布法では、生産性および塗膜の均一性を考えた場合、スライドホッパー法やエクストルージョン法が適している。これらの機能性機の形成には、その材質に 50

44 応じて蒸着法や貼り付け法等を用いることができる。 【0121】

【実施例】以下、本発明を実施例によって具体的に説明 する。本実施例では、図4の層構成、図7の等価回路か らなる積層型電池を下記の手順で組み立てた。

【0122】1. 透明導電性支持体の作製

1) 最上部の感光層用支持体

戻さ0.4mmの無アルカリガラスの基核の行面に、(VD法 によってフッ素ドープ型の二酸化スズを全面に均一一 ーティングし、原さ600 mm、面抵抗約150 / ′ □、光透 適率(500 nm)が85%の導電性二酸化スス顆を片面に 被関した透明薄電化支持体を形成した。 2) 中間流

厚さ0.4mmの蝋アルカリガラスの基板の片面に、上記の 1) と同様にしてい時によってフッ素ドーブ型の二酸 化スズを全面にサーにコーティングし、さらにもう片面 に、厚さ200 nm、面抵航約6 Ω / \square 、光透過率(500 n m) が90%の等単性にロ(インジウムスズ酸化物)をいり またして大阪の一部では、100 mm が90%の等単性にロ(インジウムスズ酸化物)をいり またして大阪の一部では、100 mm が90%の等単性にして大阪の

に、厚さ200n m、面抵抗約60/□、光遠過率(500n m) が95%の導電性ITD(インジウムス/酸化物)を170 法によって被覆し、両面が近時間導電間で被覆された支持 体を形成した。これ5の導電調のなかで、二酸化スズ膜 は、色素物繁半導体の感光層を担待する下地として、IT の膜は、対極として用いる。 【0123】2、二酸化チタン粒子含有途布液の調製

【0123】2. 一酸化ケダン和丁音与室生物の調製 に記載の製造方法に従い、チタン原料にチタニウムテト ライソプロポキンドを用い、オートクレーブ中での重合 反応の温度を200°に設定して二酸化チタン濃度11重量 %の二酸化チタン分散物を合成した。得られた二酸化チ タン粒子の一次粒子の平均サイズは約10 n mであった。 【0124】この分散物に二酸化チタンに対し30重量% のポリエチレングリコール(平均分子量20,000、和光純 素製)を添加し、温酸して粘性の塗布用エマルジョンを

【0125】3. 二酸化チタン半導体微粒子層の作製の上記1の1)と2)で作製した2種の通明等電性基板の二酸化スズ被覆面側にこの塗布液をドクタープレード法で100月mの原みで塗布し、25℃で60分間乾燥した後、電気炉で500℃にて30分間焼成して二酸化チタン層を被覆した。一酸化チタンの被覆置は10g/㎡であり、脱厚は84mであった。

【0126】4. 色素吸着溶液の調製

400-600nmまでの比較的短波技の可視波長領域に吸収 をもつ感光色素として、下記の構造式のポリメチン色素 (色素A)を、エタノール: BMSO (95:5)の混合溶媒 に0,0001mol/1の濃度で溶解し、添加剤としてケノテオ キシコール後を0.04mol/12添加し、最上部の感光層に用 いる熔線色素が吸着用溶液 Aを調製した。

[0127]

【化13】

得た。

【0128】長波長側に750nmまで吸収を持ち、青色 ~緑色領域に吸収ピークを有する感光色素として、前述 の具体例のRu錯体色素(色素R-1)を、乾燥したアセ トニトリル: t-プタノール(1:1)の混合溶媒に濃度 10 3×10-4 mol/Lに溶解して、中間部の感光層に用いる増 感色素の吸着溶液Bを調製した。

【0129】また、長波長側に900nmまで吸収を有す る赤色感光色素として、具体例のRu錯体色素(色素R- を、アセトニトリル:t-プタノール(1:1)の混 合溶媒に濃度5×10-4 mol/Lに溶解し、さらに会合防止 剤として、p-ノニルフェノキシエトキシブチルスルホン 酸ナトリウムを0.5重量%添加して溶解し、最下部の感 光層に用いる地感色素の吸着用溶液Cを調製した。

【0130】5. 色素の吸着

二酸化チタン微粒子層が塗設された基板のうち、片面が 導雷性の基板 (最上部感光層用) を、上記の吸着用色素 溶液Aに、両面が導電性の基板を吸着用色素溶液BとC に各々に浸漬して、攪拌下40℃で3時間放置した。この ようにして二酸化チタン微粒子層に色素を染着させたの ち、電極をアセトニトリルで洗浄し、最上部用、中間部 用、最下部用の3種の感光層に用いる色素増感電極を作 製した。

【0131】6. 光電池の作製

3種の色素増感Ti02電極のTi02層を1辺10mmの正方形 30 となるよう周囲の層を掻き落として面積1.0 c m2の受光 層を成形した。これらの基板を、図4の層構成にしたが って感光層と対極層が向かい合うように最上部―中間部 一最下部の順に重ね合わせた。さらに、最下部の感光層 の下には光反射性の対極として、白金蒸着ガラス基板を 配置させた。これらの基板の間には、フレーム形状のス ペーサーとして熱圧着性のポリエチレンフイルム(厚さ 20 um) を感光層を取り囲むように挿入して重ね合わ せ、スペーサー部分を120℃に加熱し精層された複数の 基板を圧着して固定した。さらにセルのエッジ部をエポ 40 キシ樹脂接着剤でシールした。

【0132】次に、スペーサーのコーナー部にあらかじ め設けた電解液注液用の小孔を通して、電解液としてY7 -2/Y8-1/37素=15:35:1(重量比)の組成から成る室温溶融 塩を50℃のもとで毛細管現象を利用して雷極間の空間に しみこませた。以上のセル組立て工程と、電解液注入の 工程をすべて上記の露占-60℃の乾燥空気中で実施し た。溶融塩の注入後、真空下でセルを数時間吸引しセル 内部の脱気を行い、終了後に注液用の小孔を低融点ガラ スで封じた。

AR. 【0133】このようにして、波長特性の異なる感光層 が稽層された本発明の色素増感半導体湿式光電池(実施 例1) を作製した。

【0134】同様の方法で、3種の感光波長領域の異な る感光層の精層の順序を変えて精層した精層型セル(実 施例5、6) も作製した(ここでは上記の方法にならっ て最上部の感光層の色素吸着には、片面導電性の基板を 適宜使用した)。また、3種の感光層のうち2種のみを 積層し、最下層に光反射性白金対極を配置した積層型セ ル (実施例2~4、7) も作製した。

【0135】さらに、長波長感光層において、上記のR-10色素で増感した酸化チタン層に代えて、同じ色素R-10 を多孔質の二酸化スズ半導体層に吸着させた長波長感光 層を用いた箱層型セル (実施例8) も作製した。この二 酸化スズ半導体の感光層は、上記の酸化チタン半導体感 光層に比べて開放回路電圧 (Voc) が基本的に低いとい う性質を持つ。

【0136】他に、比較用として、同一の色素増感半導 体管感光層を精層した精層型セル(比較例1~4)、及 20 び単一の感光層からなる単セル(比較例5~8)を用意 した。

【0137】7、光電変換効率の測定

500Wのキセノンランプ(ウシオ電気)に太陽光シミュレ ーション用補正フィルター (Oriel社製AM1.5direct) を 装着し、電池への入射光強度が100mW/cm2に調整された 模擬太陽光を照射した。

【0138】作製した光電気化学電池の電気出力を電流 電圧測定装置(ケースレー製ソースメジャーユニット23 8型) に入力し、電流一電圧特性を測定した。これによ り求められた光雷気化学雷池の短絡雷流密度(Isc)、赤 色領域650nmにおいて計測した光電流発生の対入射光 量子効率IPCE(%)、開放回路起電圧(Voc)、エネルギ 一変換効率(η)を、積層セルの層構成とともに表1に記 載した。

[0139]

[表1]

		感光層の積層構造		短絡電流密度	650nml=1517.6	短絡電流密度 650nmにおける 開放回路起電圧	エネルギー
	最上部(入射側)	中國線	最下部	Jsc	IPCE	Voc	聚被効率
実施例No.	吸着色素(半導体層) 吸着色素(半導体層)	设着色素(半導体層)	设着色素(半導体層)	(mA/cm ²)	(%)	S	%
実施例1	色素A(TiO2)	色素R-1(TiO2)	色素R-10(TiO2)	18.0	90	0.65	8.2
実施例2	色素R-1(TiO2)		色素R-10(TiO2)	16.5	55	99'0	7.6
実施例3	色素A(TiO ₂)	1	色素R-1(TiO2)	14.1	40	0.67	9.9
実施例4	色素A(TiO ₂)	1	色素R-10(TiO ₂)	16.0	20	99'0	7.4
実施例5	色素R-10(TiO ₂)	色素R-1(TiO ₂)	色素A(TiO ₂)	14.3	51	0.65	6.5
実施例6	色素A(TiO ₂)	色素R-10(TiO2)	色素R-1(TiO2)	15.2	51	99.0	7.0
実施例7	色素R-10(TiO2)	1	色素R-1(TiO2)	14.3	51	0.65	6.5
聚施例8	色素A(TiO ₂)	色素R-1(TiO2)	色素R-10(SnO ₂)	15.5	48	0.55	5.9
比較例1	色素A(TiO ₂)	同左	同左	7.0	9	0.65	3.2
比較例2	色素R-1(TiO2)	同左	同左	13.0	40	99'0	6.0
較例3	比較例3 色業R-10(TiO2)	同左	同左	13.5	20	0.65	6.2
北較例4	色素R-10(SnO ₂)	同左	同左	12.0	45	0.42	3.0
比較例5	色素A(TiO ₂)	1	1	6,9	6	0.65	3.1
比較例6	色素R-1(TiO ₂)	1	ı	12.8	37	0.66	5.9
七較例7	色素R-10(TiO2)	1	I	13.2	47	0.65	6.1
北較例8	色素R-10(SnO ₂)	1	1	11.8	42	0.42	2.9

【0140】表1の結果から、以下のことが明らかであ る。

- 1) 光学吸収波長範囲の同じ感光層を積層した比較例1 ~4は、その構成要素となっている単セル(比較例5~
- 8) と比較して、短絡雷流密度 Isc、エネルギー変換効 率ともにほとんど変化が見られないのに対して、本発明 40 の条件に従った積層構造の実施例1~8はJsc及びエネ ルギー変換効率が向上する。
- 【0141】2) 実施例3と実施例4の比較から、上層 部の感光層が同一の場合は、最下層部に置かれる感光層 の吸収波長がより長波長に及ぶものほど高いIscと高い エネルギー変換効率を与える。
- 【0142】3) 実施例1,5,6の比較から、同一の 単セルの組合せを用いる積層セルでは、光学吸収波長範 囲の長波長端がより短波長の順に上層部(入射側)に配 置するほうがより高い Jscと高いエネルギー変換効率を 50 40・・・対極導電層

【0143】4) 実施例1, 8の比較から、セルを構成 する単セルの開放回路起電圧 Vocが0.65~0.66 V とほぼ 近い範囲にある実施例1に比べて、単セルのVocが0.42 ~0.66Vの範囲でばらつく実施例8では積層セルにおい てVocが低下しているが、これは3種の単セルのVocの 標準偏差が平均値に対して与える割合が19%と大きく、 単セル間の Vocの変動が大きいためである。しかし、実 施例8は比較例1~8と比較するとJscが高いというメ 10 リットを有する。

48

【0144】このように、上記実施例の結果から、本発 明の方法に従って作られる積層型太陽雷池が、集光効率 とそれを反映するJsc, IPCEの点で優れ、高いエネルギ 一変換効率を与えることがわかる。また、とくに、請求 項に示した各種要件を満たすセルにおいてはより高いエ ネルギー変換効率を与えることがわかる。

【発明の効果】以上詳述したように、本発明の光電変換 素子は、集光効率が高くエネルギー変換効率に優れてい 20 る。したがって、かかる光電変換素子からなる光電池

【図1】 本発明の好ましい光電変換素子の構造を示す

【図2】 本発明の好ましい光電変換素子の構造を示す 部分断面図である。

【図3】 本発明の好ましい光電変換素子の構造を示す 部分断面図である。

【図4】 本発明の好ましい光電変換素子の構造を示す 30 部分断面図である。

【図5】 本発明の好ましい光電変換素子の構造を示す 部分断面図である。

【図6】 本発明の好ましい光電変換素子の構造を示す 部分断面図である。

【図7】 本発明の好ましい光電変換素子の等価回路を 示す断面図である。 【図8】 本発明の好ましい光電変換素子の等価回路を

示す断面図である。 【符号の説明】

1・・・光電変換素子

1a・・・リーク孔 10・・・導電層

10a · · · 透明導電層 11・・・金属リード

20、20a、20b、20c・・・感光層 21・・・半導体微粒子

22 · · · 色素

23 · · · 雷荷輸送材料

30···電荷移動層

与える。

[0145]

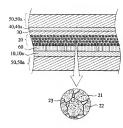
は、太陽雷池として極めて有効である。

【図面の簡単な説明】

部分断面図である。

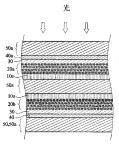
40a・・・透明対極導電層 50・・・基板 50a・・・透明基板 60・・・下塗り層 2・・・外部回路

[図1]

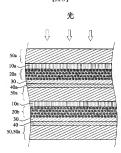


【図2】

50



[図3]



[図4]

* J J J

